

高雄市和發產業園區
產業用地(二)土地出(標)售手冊

開發單位：高雄市政府

中華民國一〇九年一月 編印

高雄市和發產業園區 產業用地(二)土地出(標)售手冊

目 錄

第一部分 開發背景說明.....	1
壹、和發產業園區開發簡介.....	2
第二部分 高雄市政府公告文件.....	7
貳、高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售公告.....	8
參、高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售要點.....	11
附件 3-1 和發產業園區產業用地(二)容許引進產業類別.....	21
附件 3-2 和發產業園區資源或污染物單位面積核配基準.....	23
附件 3-3 和發產業園區危害性化學物質原料使用總量.....	24
附件 3-4 和發產業園區污水處理納管水質限值.....	25
附件 3-5 和發產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項.....	26
附件 3-6 危害性化學物質清單.....	36
附件 3-7 土地買賣契約書.....	58
肆、和發產業園區土地使用分區管制要點.....	61
伍、和發產業園區建築景觀預審規範.....	69
陸、和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則.....	84
第三部分 出(標)售土地面積及出(標)售價格.....	98
捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及 出(標)售價格.....	99
第四部分 申購流程及應備書件.....	102
玖、和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售作業流程.....	103
拾、指定繳款行庫帳戶一覽表.....	104
拾壹、和發產業園區產業用地(二)土地申購書件.....	105

第一部分 開發背景說明

壹、和發產業園區開發簡介

(一) 開發緣起與目的

高雄市已開發工業區使用率達九成以上，已無土地可供設廠，且多數皆屬開發達二十年以上之老舊工業區，公共設施供給不足，整體空間品質不良。

近年來台商回流已呈趨勢，導致產業用地之需求有回復跡象。同時，部分國內廠商為因應全球化與經營需要，有增資擴廠需求，惟高雄市已無用地可供擴廠，因而希望就近另覓設廠用地擴建，以持續其產業發展，除能節省搬遷費用外，並可維持在地既有的員工和生產網絡。

高雄市政府乃推動和發產業園區，期望以完善的基礎建設，因應產業發展情勢，協助在地優勢產業有效提升競爭能力，朝向高值化發展。和發產業園區之開發目的如下：

1. 滿足區域性產業空間發展需求：藉由新產業園區之開發，提升基礎建設之品質，強化發展所有產業之根本，滿足區域性產業空間發展之需求，以利形成對土地資源有效運用發展的動力引擎。
2. 扭轉傳統工業區形象、提升地區競爭力：引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉重工業城的形象，使大寮區集結成高雄市重要的金屬產業據點。
3. 強化產業網絡，提升優勢產業競爭力：提供地方優勢產業及具潛力之新興產業進駐，強化產業群聚效能，厚植地區產業實力。
4. 促進產學合作寬度與深度：以產業生產空間與教學環境之結合，增加產學合作機會，以綠色科教意象重塑產業園區形象。

(二) 區位概述

1. 位置

和發產業園區位於高雄市大寮區，總面積約 136.13 公頃，分為和春基地（約 81.81 公頃）及大發基地（約 54.32 公頃），兩處基地均位屬「大坪頂以東地區都市計畫」內，位置詳圖 1。

和春基地位於大寮區琉球里的台 29 線（民國 103 年 7 月 16 日台 21 線南段改稱台 29 線）與高 68 線交界，基地西界是上寮幹線，北為台糖公司開發之萬大工業區，東鄰台 29 線、大寮堤防及高屏溪，東南角為水公司之給水廠及部分住宅，南隅與和春技術學院相接；南隔高 68 線與大發基地之距離約 1 公里。

大發基地位於大寮區上寮里的台 88 線(平面路段屬 188 線)與台 29 線交界處，基地西界是上寮排水，東鄰台 29 線、大寮堤防及高屏溪，東南隅為萬大大橋，南隔台 88 線與大發工業區相接，亦即位於大發工業區北側。

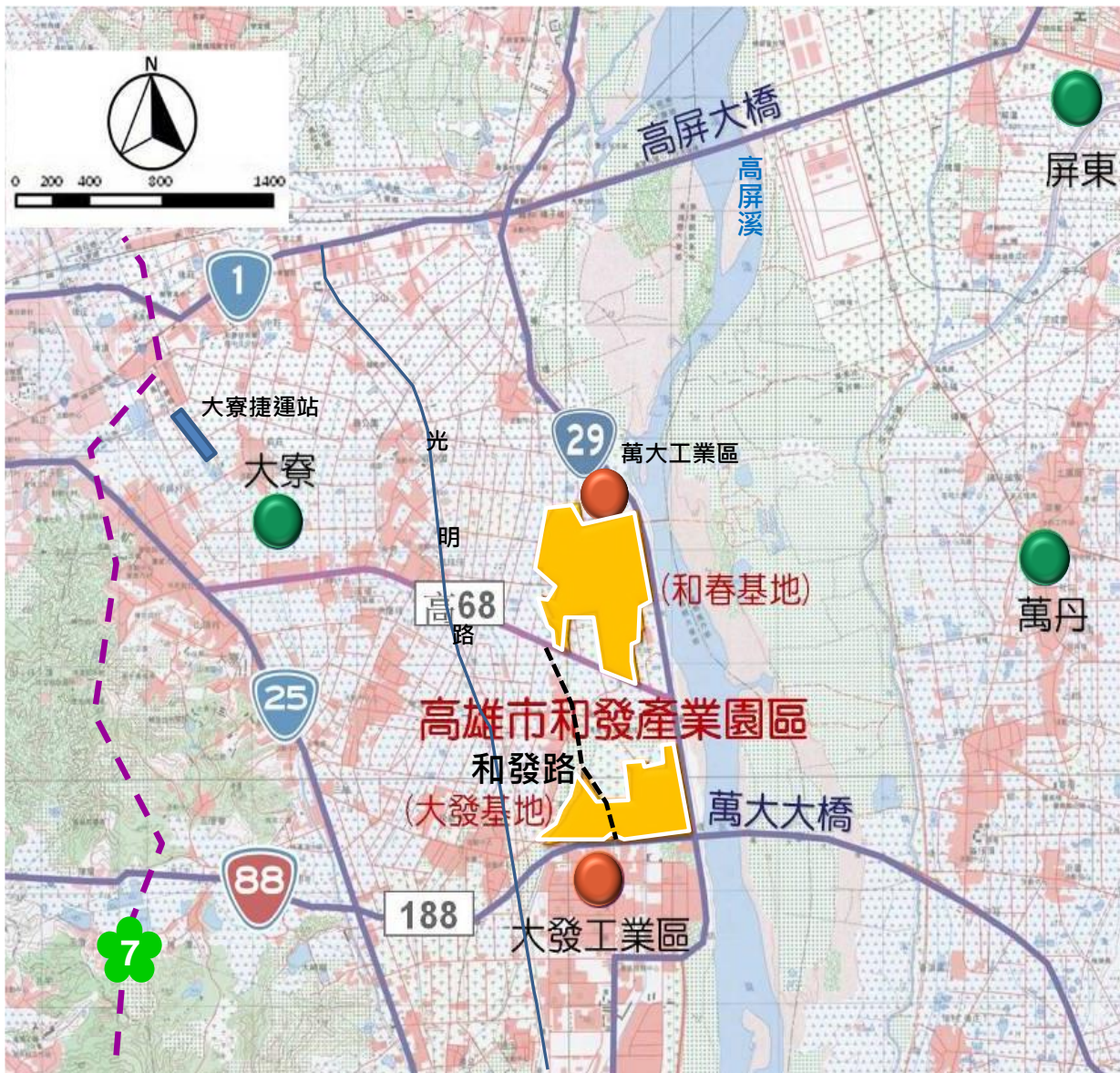


圖 1 和發產業園區位置示意圖

2. 交通運輸

和春基地南側緊鄰高 68 線，東側緊鄰台 29 線；大發基地南側緊鄰台 88 線，東側亦緊鄰台 29 線。整體而言，本園區聯外交通十分便捷。

3. 氣候

和發產業園區屬熱帶性季風氣候，終年高溫，冬季不甚明顯，降雨及風向變化則較明顯。年平均溫度約 25.1°C，月平均降雨量為 156.8 公厘，雨水集中於夏季 5~9 月，而冬季 10 月至翌年 3 月之雨量不及全年雨量之 10%。年平均日照時數約 2209.8 小時，高於台灣其他地區。

4. 人口與勞動力分析

就高雄市近年人口成長趨勢來看，人口總數仍持續增加。且高雄市二級產業就業人數近年維持穩定，其中製造業就業人數已達三分之一，顯示高雄市製造業所佔分量極為顯著。未來經由和發產業園區產業引進與發展，增加當地就業機會。

5. 地形與地質

和發產業園區近高屏溪出海口右側之沖積平原區，地形平坦。另在基地西側約 1.6 公里處有一北北西走向之鳳山斷層，位於鳳山低矮丘陵與屏東平原之間，鳳山斷層為一存疑性活動斷層，斷層本體未通過園區，影響不大。

(三) 開發計畫

和發產業園區包含大發基地及和春基地，產業用地總面積約 92.47 公頃、管理及公共設施總面積約 43.66 公頃，為滿足廠商進駐時程需求，採全區一次開發方式進行，公共工程自民國 104 年 11 月動工，預計至 109 年 8 月底完工。截至 108 年底，本園區產業用地(一)之出售部分業已完售、出租部分出租率已達 89.5%(不含標準廠房)，合計申租購廠商家數達 88 家，其中並有 31 家興建中、17 家進入生產營運階段，預定引進員工數 9 千餘人，園區整體發展狀況良好。

(四) 提供設施

1. 道路系統

和發產業園區毗鄰之台 29 線、高 68 線及台 88 線(平面路段為 188 線)為主要聯外道路，園區內道路以主要道路及次要道路為主，主要道路為連接基地與聯外道路之主要出口，並聯繫各坵塊，為園區主要之交通動脈；次要道路為輔助主要道路之功能，連繫各廠區、辦公室、公共服務設施，以構成一完整之路網。

2. 綠地及綠帶

運用節點、綠廊、地標、端景等空間的串聯，共同建構豐富多元的生態網絡系統，並延續銜接至周圍環境的生態體系中，共同構築和發產業園區之整體景觀空間架構。

3. 雨(排)水系統

配合既有排水現況與集水區，在降低土方需求之條件下採重力排水方式為原則。透過道路側溝收集系統，經由排水分線、支線及排水幹線，收集匯流至排水閘門，而後排放至各水道或外海。

4. 給水系統

依據產業用地出售預定進定及預定進駐廠商以機械設備製造修配業為主，並尚有金屬製品、運輸工具及電子零組件等產業，各產業之用水量推估乃依據經濟部水利署於 94.10.06 最新修正「用水計畫書審查作業要點」之附件 3-3「單位用水量計算參考」之工業用水量規劃建議值，平均日用水量推估為 5,500 CMD，最大日、最大時需水量以平均日需水量之 1.3、2.0 倍估算，分別為 7,150 CMD、11,000 CMD。

本園區短期水源部分，預定由鳳山給水廠供給，區外輸水幹管為基地東側台 29 省道 ϕ 400mm 幹管，和春基地預定自該 ϕ 400mm 幹管取水，導入基地內之自來水用地。大發基地區外輸水幹管有二處：一為基地東側台 29 省道 ϕ 400mm 幹管、另一為基地南側大發工業區內華中路 ϕ 400mm 幹管。本基地預定自東側台 29 省道之幹管取水，導入基地東北角之自來水用地，為區內未來開發營運所需用水。

5. 電力系統

參考台南樹谷園區、南科高雄園區及岡山本洲工業區之發展經驗，採負載密度法進行推估，依預定引進產業類別及用電密度推估得本計畫最高總用電量約 93,838 KW，將可滿足用戶需求。

計畫基地開發初期可利用附近台電之上寮 S/S 剩餘之電力，提供施工建廠及初期用戶營運之用電需求。但現有電力設施無法滿足終期最高用電需求，為提供充裕穩定可靠之電力，已協調台電公司於大發及和春基地內各設置一座 D/S，以因應未來負載成長之需求。

6. 電信系統

預估和春基地之電信需求量語音約 1,500 對，非語音約 300 埠；大發基地之語音約 1,000 對，非語音約 200 埠。為因應各電信業者提供寬頻電信趨勢，管道規劃亦須考量光纜及銅纜所需之空間。電信工程管數，將以中華電信、三家民營固網、一家有線電視業者及工業區專用之監控系統管道等進行規劃。

7. 污水系統

兩處基地雨污排水採分流方式規劃，污水處理廠設置於大發基地，除收納大發基地污水下水道所匯集之工業廢水和生活污水外，亦將容納和春基地之污水；和春基地僅規劃污水抽水站，污水收集後經撈污除砂，以泵揚藉壓力管線輸送至大發基地污水廠初級處理單元（PH 調整池），與大發基地之污水合併處理至陸放標準後，排放至林園大排。

8. 廢棄物處理系統

一般事業廢棄物適燃部份可送至仁武垃圾資源回收(焚化)廠，已協調該處資源回收廠同意代為處理。一般事業廢棄物不適燃部份須直接掩埋者，送至高雄市境內公民營廢棄物處理機構之掩埋設施處置。

基地可能產生之有害事業廢棄物包括廢溶劑、污泥與廢液等，由廠商自行清運或委託合法清除機構代為清運，並由廠商自行依環保法規辦理並申報。

9. 公共服務設施

本園區將於和春基地設立服務中心，提供園區內廠商行政服務、會議展示、人才培訓、餐飲接待、資訊控制、防災中心等功能。

第二部分 高雄市政府公告文件

貳、高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售公告

發文日期 中華民國 108 年○月○日

發文字號 高市府經工字第○號公告

主旨：公告出(標)售高雄市和發產業園區產業用地(二)土地，並自公告日起受理申請。

依據：

- 一、產業創新條例暨其施行細則及其子法。
- 二、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法。

公告事項：

- 一、出售土地標示：詳本出(標)售手冊「捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格」。
- 二、申購土地申請書表備索地點
 - (一) 自行於高雄市政府(以下簡稱本府)經濟發展局網站(資訊專區-公告)下載(網址：<https://edbkcg.kcg.gov.tw/News.aspx?n=9A7F03ABA05E4DEF&sms=BE8A73D3A0435784>)
 - (二) 本府經濟發展局(地址：高雄市苓雅區四維三路2號9樓 電話：07-3373164)
 - (三) 合發土地開發股份有限公司(以下簡稱合發公司)(地址：高雄市苓雅區四維三路80號4樓之2 電話：07-3315398)
- 三、出售對象：本公告適用範圍，以從事產業創新條例相關規定之使用為限，並應符合和發產業園區產業用地(二)容許引進產業類別。
- 四、應繳價款：申購本區土地應繳價款包含申購保證金、土地價款及產業園區開發管理基金，計算方式如下：
 - (一) 申購保證金：按土地價款之3%計算，此項保證金於承購案核准時，得無息抵充應繳之土地價款；未經核准承購者，無息退還；惟申請人經核准承購後，無故未依規定履行承購之義務者，沒入本項保證金。
 - (二) 土地價款：依產業創新條例第46條規定審定，詳本出(標)售手冊「捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格」。
 - (三) 產業園區開發管理基金：按土地價款之1%計算。
- 五、受理申請時間、地點、程序及應備文件
 - (一) 申請人自公告日起至109年8月31日於上午8時至下午5時30分止，可分別向公告事項二之網站或地點自行下載列印或領取申請書表。

- (二) 申請人應備文件內容及份數，請參閱本出(標)售手冊「參、高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售要點」之規定。
- (三) 受理期間：公告日起至 109 年 8 月 31 日止，每日上午 8 時至下午 5 時 30 分（例假日除外，中午 12 時至下午 1 時 30 分休息），在合發公司受理申請。通訊申請者，恕不受理。
- (四) 申請案件由合發公司初審，必要時，得邀集專家學者及相關機關召開會議，申請人應配合出席簡報，並於文件齊全、資格符合後，提請本府經濟發展局審查確認。
- (五) 申請案件經初審其文件不齊或不符合和發產業園區使用相關規定者，視為資格不符，無息退回申購保證金。
- (六) 申請案件經初審應予補正者，申請人應自合發公司書面通知補正之日起 1 個月內補正，未於期限內補正者，視為放棄申購資格，並無息退還已繳交之申購保證金。
- (七) 公告受理期間，以每 1 個月為 1 批次檢視受理案件申請狀況（每月第 1 批次以當月第 1 日為起始日，當月最後 1 日為截止日；各批次起始日或截止日倘遇例假日不順延，申請人應自行注意並提前申請。第 1 個月第 1 批次起始日以本手冊公告受理起始日為準），如同一批次有二申請人以上申購同一土地坵塊且經本府審查符合資格者，以下列條件決定優先順位，優先順位一致時，由本府擇期邀請申請人提出價格標單，並以有效標單之投標金額超過公告出(標)售價格且為最高價額者為得標廠商；次高標價者為次得標人。最高價額有二標以上相同者，授權標場主持人抽籤決定得標人及次得標人；次高標價者有二標以上相同時，比照辦理。
 - 1. 本批次申購土地面積合計最高者為第一優先順位，惟應以本府公告之完整土地坵塊面積累加，要求本府額外分割土地坵塊者，額外分割所增加之土地坵塊面積不得計列。
 - 2. 已核准購地之申請人增購相鄰土地坵塊者為第二優先順位。
- (八) 為促進土地合理及整體利用，本府得依可售土地規模並綜合申請人之用地需求計畫，協調並核准申購土地面積或位置。

六、完成使用之認定標準及產權移轉規定

- (一) 核准土地承購人應於土地產權移轉之日起 3 年內完成建築使用，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承購土地面積之 30%，並應取得目的事業主管機關核准登記或營運許可證明文件，始符合完成使用之規定。
- (二) 核准土地承購人未依規定完成使用，悉依產業創新條例第 46-1 條及產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法相關規定辦理。

七、其他

- (一) 本公告如有未盡事宜，悉依本公告所依法規事項辦理。
- (二) 凡對上開公告事項有疑問者，請向本府經濟發展局(電話:07-3310198)或合發公司(電話:07-3315398)洽詢。

參、高雄市和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售要點

【法規依據】

- 一、本要點依產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第3條規定訂定之。
- 二、高雄市和發產業園區(以下簡稱本園區)入區標準及土地使用規範依各級都市計畫委員會及環境影響評估審查委員會決議內容予以規範。
- 三、本園區產業用地(二)土地(以下簡稱本區土地)之出(標)售,依本要點規定辦理。本要點未規定者,依產業創新條例暨其施行細則及其子法,以及其他相關法令規定辦理。

【受理單位】

- 四、本區土地出(標)售相關事宜,由高雄市政府(以下簡稱本府)授權委託合發土地開發股份有限公司(以下簡稱合發公司)辦理。

【出(標)售標的】

- 五、本出(標)售要點適用範圍為本園區產業用地(二)土地,詳本出(標)售手冊「捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格」。
- 六、本區土地之出(標)售依本府規劃開發圖說辦理開發,並依規劃坵塊申請,申請人不得要求增設任何公共設施;並應於申購時對公共設施尚未完成之情形充分了解,並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款。

【出(標)售對象】

- 七、本要點適用範圍,以從事產業創新條例相關規定之使用為限,並應符合本要點附件3-1所列引進產業類別。

【出(標)售程序】

- 八、申請人應依本區土地出(標)售公告所指定之時間、地點,檢齊下列文件一式十份向合發公司申請。
 - (一)申請書
 - (二)投資營運計畫書
 - (三)繳納土地價款3%計算之申購保證金憑證影本,請向指定行庫帳戶繳納取據(未附申購保證金繳納憑證影本或金額不足或不符規定繳交方式等,屬無法補正事項,視為資格不符,並不受理其申請)。
 - (四)申購土地位置圖
 - (五)承諾書(請蓋騎縫章)

申請人申請混合使用產業用地(一)之容許引進產業類別時，應填寫本手冊土地申購書件六、混合使用產業用地(一)容許引進產業類別計畫書，並自行參閱本園區產業用地(一)土地出(標)售手冊相關規定。

- 九、申請案件由合發公司初審，必要時，得邀集專家學者及相關機關召開會議，申請人應配合出席簡報，並於文件齊全、資格符合後，提請本府經濟發展局審查確認。
- 十、申請案件經初審其文件不齊或不符合和發產業園區使用相關規定者，視為資格不符，無息退回申購保證金。
- 十一、申請案件經初審應予補正者，申請人應自合發公司書面通知補正之日起1個月內補正，未於期限內補正者，視為放棄申購資格，並無息退還已繳交之申購保證金。
- 十二、公告受理期間，以每1個月為1批次檢視受理案件申請狀況（以當月第1日為起始日，當月最後1日為截止日；各批次起始日或截止日倘遇例假日不順延，申請人應自行注意並提前申請；第1個月第1批次起始日以本手冊公告受理起始日為準），如同一批次有二申請人以上申購同一土地坵塊且經本府審查符合資格者，以下列條件決定優先順位，優先順位一致時，由本府擇期邀請申請人提出價格標單，並以有效標單之投標金額超過公告出(標)售價格且為最高價額者為得標廠商，次高標價者為次得標人；最高價額有二標以上相同者，授權標場主持人抽籤決定得標人及次得標人；次高標價者有二標以上相同時，比照辦理。
 - (一)本批次申購土地面積合計最高者為第一優先順位，惟應以本府公告之完整土地坵塊面積累加，要求本府額外分割土地坵塊者，額外分割所增加之土地坵塊面積不得計列。
 - (二)已核准購地之申請人增購相鄰土地坵塊者為第二優先順位。
- 十三、為促進土地合理及整體利用，本府得依可售土地規模並綜合申請人之用地需求計畫，協調並核准申購土地面積或位置。
- 十四、申請人原繳之申購保證金於申購案核准時，得無息抵充應繳之土地價款；惟申請人經核准承購後，非因不可歸責於申請人之因素而未依規定履行承購之義務者，沒入本項保證金。
- 十五、本府經濟發展局應於審查確認後，依核准承購與否，通知申請人限期繳款或無息退還原繳申購保證金。

【申購保證金不予退還之事由】

- 十六、申請人有下列情形之一者，本府得撤銷其承購之核准，其原繳申購保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：

- (一) 申請人於接獲核准承購通知書後，非因不可歸責於申請人之因素而未依規定履行承購之義務者。
- (二) 逾期未繳清土地價款(含產業園區開發管理基金)者。

【名義變更之限制】

十七、申請人自申請承購本區土地之日起，在未完成土地所有權移轉登記前，除依法更名外，不得變更申請人名義。

【使用限制】

- 十八、申請人同意確實遵照申購土地租售審查時所提出之「投資營運計畫書」於預定完成使用期限內盡其最大努力，具體實現該計畫之內容。但因產業發展趨勢、經濟變遷或其他企業營運考量，致需變更或調整「投資營運計畫書」之內容者，不在此限。
- 十九、前點但書情形，於申請人提出變更或調整「投資營運計畫書」時，經本府以書面通知後，申請人應於期限內檢具具體事證及說明(如具公信力之第三單位之產業報告或調查)向本府專案報告。申請人逾期未提出相關說明者，視為違反買賣契約之約定，經本府認定情節嚴重者，得解除買賣契約。

【完成使用認定標準】

- 二十、申請人應於土地產權移轉之日起 3 年內完成建築使用，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承購土地面積之 30%，並應取得目的事業主管機關核准登記或營運許可證明文件，始符合完成使用之規定。
- 二十一、申請人未依規定完成使用，悉依產業創新條例第 46-1 條及產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法相關規定辦理。

【應繳價款】

- 二十二、申請人申購本區土地應繳價款包含申購保證金、土地價款及產業園區開發管理基金，其計算方式如下：
 - (一) 申購保證金：按土地價款之 3% 計算，此項保證金於承購案核准時，得無息抵充應繳之土地價款；未經核准承購者，無息退還。
 - (二) 土地價款：依產業創新條例第 46 條規定審定，詳本出(標)售手冊「柒、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格」。
 - (三) 產業園區開發管理基金：按土地價款之 1% 計算。

【繳款方式】

二十三、申請人於接獲核准購地公文 2 個月內或本府經濟發展局指定期限內，

向指定行庫帳戶繳清全部土地價款及產業園區開發管理基金後，辦理簽約、點交土地並核發土地產權移轉證明書件。

- 二十四、申請人因故延期繳款，應於繳款期限屆滿前向本府提出申請，展延次數以 1 次為限，且不得超過 2 個月，申請人應切結負擔延遲期間之利息，利息以台灣銀行當期基準利率(按月)逐日計算；逾期未繳清價款者，本府得視為放棄申購，沒入原繳申購保證金。

【土地點交】

- 二十五、申請人依繳款通知繳清土地價款及產業園區開發管理基金後，原則於 2 個月內完成土地點交及買賣契約簽訂，並以土地點交日為簽約日。點交方式由本府(委託合發公司)以書面通知申請人至現場按現況點交土地，並確認申購土地邊界及樁位點，申請人無故不到現場點交者，由本府以書面通知再次催告，仍不到場點交者視同已點交。
- 二十六、申購土地自點交之日起，其所受之利益及危險，均歸屬申請人負擔，不因土地產權未移轉而受影響，申請人對其承購之土地應負責維護管理，並須盡善良管理人之注意義務。
- 二十七、申請人於點交土地時應對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款或點交。

【買賣契約簽訂、解除及違約責任】

- 二十八、為明確申請人與本府土地買賣相關權利義務關係，申請人應於繳清土地價款及產業園區開發管理基金後，於本府通知期限內完成買賣契約之簽訂；申請人無故未依規定簽訂契約者，本府得視為放棄申購，沒入原繳申購保證金，其餘價款無息退還。
- 二十九、申請人簽約後如違反法令及本園區規定，致本府受有損害時，申請人並應依法賠償本府所受之一切損害。

【土地稅賦】

- 三十、申請人應自土地點交之日起依本府通知期限按時繳交申購土地相關土地稅賦，未滿一年者，按日計算。

【面積結算】

- 三十一、申購土地實際面積以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準，如有誤差應就超過或不足部份按原出(標)售價格相互找補土地價款。
- 三十二、申請人於辦妥產權移轉登記後，如因地政機關地籍圖重測或複丈致面積變更者，應按地政法規相關規定辦理。

【興建須知】

- 三十三、申請人使用申購土地，所需用水量、廢(污)水排放量、用電量、污染物總量及危害性化學物質應確實依本府審查決議事項辦理，本園區排放污染物單位面積核配基準參見本要點附件 3-2(申請人於建廠前如「和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定有變更，悉依最新規定辦理)，危害性化學物質管制種類及總量參見本要點附件 3-3，危害性化學物質清單參見本要點附件 3-6，申請人應自行比對有無使用危害性化學物質。
- 三十四、申請人構築建物、設立工廠，應依照建築法、環保法規、本園區都市計畫書圖、本園區土地使用分區管制要點、本園區污水下水道管理辦法、本園區建築景觀預審規範、工廠管理輔導法及其他相關法規辦理，並應以申請人之名義為起造人。
- 三十五、申請人若在高雄市原已有設廠且需申請空污排放許可者，應優先於舊廠自行減量。
- 三十六、申請人須提出污染物排放量(參見本出(標)售手冊「拾壹、和發產業園區產業用地(二)土地申購書件」)向本府申請，若超出本園區排放污染物核配基準時，於符合「和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定時，超出之污染量應向本府申請調撥污染物排放量並應經本府審查同意。申請人應於調撥期間繳納環境回饋金，環境回饋金依「和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定計算，申請人需簽訂調撥及減量切結書，後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率。前述污染物調撥量為暫時撥借，並非可無限期進行調撥，未來如區內廠商或後續入區廠商有需求，應無條件歸還或配合調整調撥量，故申請人應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。
- 三十七、申請人須提出危害性化學物質運作種類及數量(參見本出(標)售手冊「拾壹、和發產業園區產業用地(二)土地申購書件」)向本府或本園區服務中心申請，以統計是否符合本園區環評承諾運作量，若超出危害性化學物質管制種類及總量，需辦理環境影響評估變更後始得進駐。後續若因製程或原料改變，而導致原申請危害性化學物質運作種類及數量增加時，需向本府或本園區服務中心申請，並辦理環境影響評估變更經環保主管機關審查通過始得增加。
- 三十八、本園區總致癌風險值增量上限為 3.51×10^{-7} 。若經計算之健康風險有超出前開上限值情形，申請人應配合本府要求進行危害性化學物質減量等相關措施，若因申請人因素而需辦理環境影響評估變更時，申請人

應自行付費辦理。

- 三十九、申請人於施工前應提出營建工程逕流廢水污染削減計畫書，以及空氣污染防制計畫書(含污染防治設施經費)，送當地環保局同意後，始得開工。空氣污染防制計畫書內容應具體、量化，可供查核；項目應包含：工程基本資料、環境座落及場內設施平面配置圖說、施工期程圖說、砂石土方產生量、空氣污染物排放源及排放量、各施工項目依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行之防制設施(另增加監控設施)內容，包括設施種類、效能、流程、使用狀況及其設計圖說。
- 四十、申請人應將本府提供之「施工環境保護執行計畫」納入與承包商契約及施工規範，明訂工地環保作業要點及罰則，並要求承包商據以提出「工地環境保護工作執行計畫」並據以執行。
- 四十一、申請人應依本府研定之交通維持原則，納入工程合約中，責成承包商依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」，依本府相關規定送審。
- 四十二、申請人在土地點交前，不得擅自開挖土方、傾倒廢棄土或構築工事，倘因而發生損害時，應負賠償責任，但經本府同意其須於土地上作檢測等必要工事者，不在此限。
- 四十三、營建剩餘土石方之處理，以於本園區土地內就地整平為原則。園區整地完成後，申請人如有建築餘土或土石方需求，應依「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」、「高雄市和發產業園區租購地廠商建廠工程土石方管理辦法」等相關規定辦理，申請人提送之相關申請書件需先經本府或本園區服務中心同意；若有涉及需辦理環境影響評估變更之情形，需俟甲方完成環境影響評估變更程序後，方得向本府或本園區服務中心申請土石方相關之證明文件，並應依變更後之環境影響評估報告所載內容辦理。
- 四十四、申請人應考量提高建築用地之防洪標準，建築基地一樓樓地板之建議高程如本要點附圖所示。
- 四十五、本園區採用雙元供水系統，工業用水與民生用水由不同管線供給，申請人建廠時應預留雙元供水系統之管線及接水點。
本園區自來水及再生水應採用具自動傳輸功能之電子式水表，並應預留(埋)管路或透過內線(電信箱)連接至電信分歧管。
- 四十六、申請人應考量可承擔之缺水風險後，自行設置 1 日以上用水量之蓄水設施；若用水量大於 1000 CMD 者，應自行設置滿足 3 日以上用水量之蓄水設施。
- 四十七、本園區建築物主結構應以鋼筋混凝土或鋼架等耐火材料為主，建築物

- 及基地出入口不得阻礙或破壞現有排水系統，且不得對道路交叉口截角開設，以維持交通安全。
- 四十八、申請人整地或構築建物期間應依據相關法規設置臨時滯洪沉砂池，妥為儲滯施工中之地面逕流水，避免基地土壤沖刷流失。
- 四十九、申請人整地或構築建物應自行設置排水系統將廠區之排水導入排水溝內，不得漫流，以免危害土坡或構造物之安全。
- 五十、雨污水收集系統應採分流設計，不得將污水排入雨水系統中或將雨水排入污水系統中，另應加強廢水回收再利用，並納入申請書附件之用水計畫內容。
- 五十一、本園區內各項公共設施不得加以破壞，違者應負責修復或賠償。
- 五十二、申請人如需變更既有公共設施者，應先提出施工計畫書送經本園區服務中心核可後始得施工，相關設施遷移及復原所需費用，由申請人自行負責。
- 五十三、申請人構築建築物時，若毀損已完工之公共設施，申請人於修復並經本府或本園區服務中心確認無誤後，始得請領使用執照。
- 五十四、申請人構築建物時，若需埋設基樁，為避免損及鄰近地下及地上結構物，應注意適當之安全距離並遵守相關法規規定，以避免造成施工公害；倘因而發生損害或公害時，應負賠償或修復責任。
- 五十五、申請人使用本園區土地所產生之廢(污)水應依下水道法、本園區下水道管理辦法及本園區污水處理廠營運管理要點等規定，申請納入本園區廢(污)水下水道系統處理，並於連接園區下水道系統前，完成廢污水採樣井、流量計及制水閥之設置；其排放水質應符合本園區公告之污水處理納管水質限值後始得排入。若排放水質超過納管水質限值，應自行於廠內規劃設置污水處理設施，進行廢污水納管前處理。惟於本園區污水處理廠完工前，申請人所產生之廢(污)水由本府另行設置污水應急處理設施處理，相關費率及繳費方式由本府另行公告。
- 五十六、申請人使用承購土地所產生之廢(污)水，申請納入本園區污水處理廠處理時，應依本府核定之污水處理系統使用費率，按月繳交污水處理系統使用費；倘其排放之廢(污)水量大於規定標準者，其超過原規劃設置標準之廢(污)水排放量，另依該費率分級徵收之。
- 五十七、申請人排放之廢(污)水量如超過原規劃設置之污水管線容許量時，應自行評估設置專用污水排放管線銜接至污水處理廠，並提出施工計畫送經本府核可後施作，所需各項費用自行負擔。
- 五十八、本園區電力供應採 11.4/22.8 仟伏特系統配電，申請人申請用電契約容量未達 15,000 瓩者，採 11.4/22.8 仟伏特系統供電；達 15,000 瓩以上

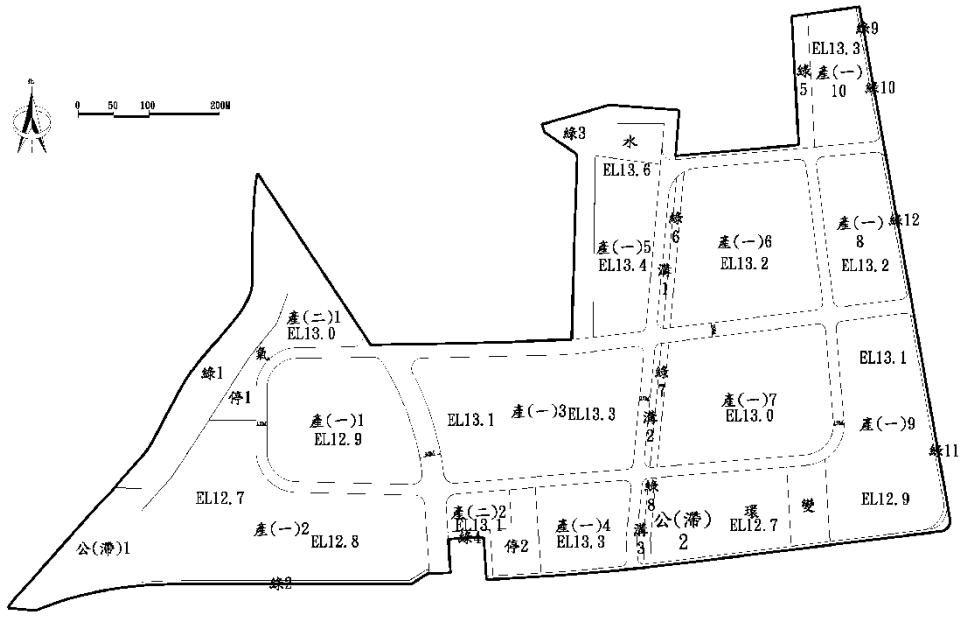
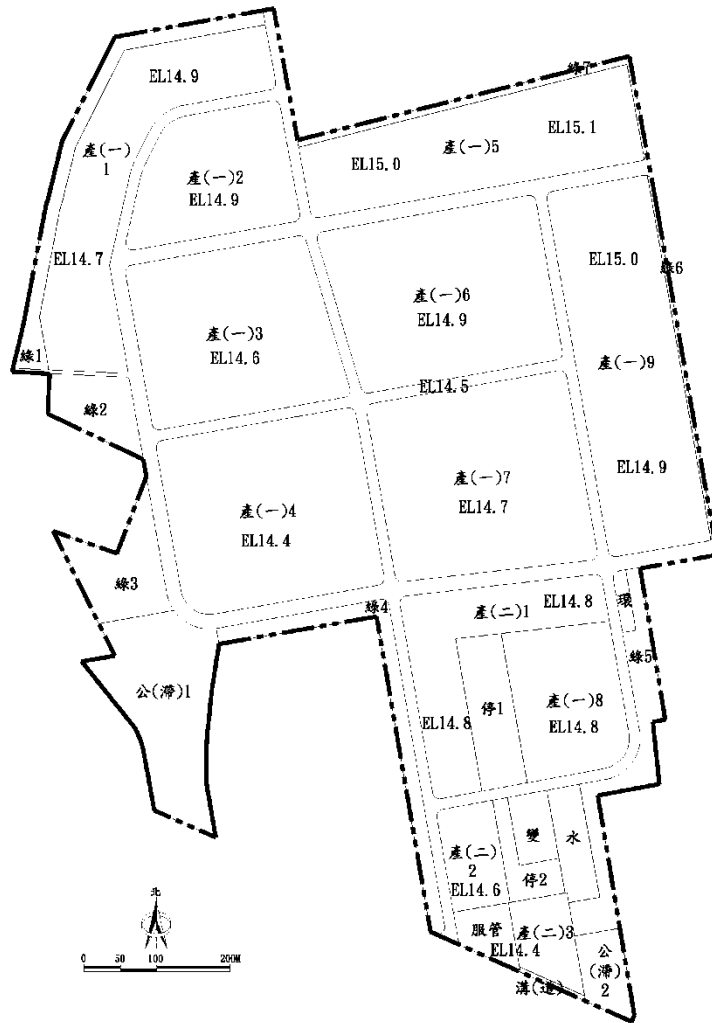
- 者，採 161 仟伏特系統供電，並應依台灣電力公司之規定設置接電裝置。
- 五十九、申請人應依其生產方式及用電需求，逕洽台灣電力公司申請供電，或自行設置發電或汽電共生設備，並依台灣電力公司規定及供電系統所需，提供場地供裝設開關箱／變電箱之用。
- 六十、申請人不得在公共道路上裝卸貨物、堆置物品、棄置廢棄物及停放車輛，以維護交通安全。
- 六十一、申請人於構築建物、設立工廠，於進行整地、地下基礎開挖等工事前，應行文報知本府；倘因而違反「環境影響評估法」、「高雄市和發產業園區環境影響說明書（定稿本及送環保署審查同意之變更書件）」及相關環保規定，應負連帶賠償責任，並依相關規定辦理。
- 六十二、申請人於施工建築期間，應遵守本園區之安全衛生管理辦法，以落實開發區之人員、車輛及機具管控，確保園區內之施工安全。
- 六十三、申請人如為行政院環境保護署依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，應於設立、停業、歇業或移轉土地所有權時，應依土壤及地下水污染整治法第 8 條及第 9 條規定自行辦理土壤污染檢測作業並提供本府乙份，所需費用自行負擔。
- 六十四、前點污染檢測資料，應同時檢送本園區服務中心 1 份，並應包括下列事項：
- (一) 事業基本資料：事業名稱及負責人、統一編號、地址、地號、土地使用類別、廠區配置圖、土地使用人、管理人或所有人及聯絡方式等。
 - (二) 事業運作情形：生產製程、使用原料、產品、污染來源、污染物種類與成分、處理情形及相關污染防治措施。
 - (三) 檢測及分析結果：檢測項目、採樣檢測方法、檢測數量及品保品管等。
 - (四) 檢測機構：機構名稱、地址及許可文件影本。
 - (五) 其他經主管機關指定之資料。
- 六十五、倘因申請人使用申購土地，致該土地遭公告為土壤污染控制場址時，申請人應依法提出污染控制計畫，並採取污染防治措施，以避免污染之擴大並儘速使申購土地解除土壤污染管制區劃定。至倘因相關環保法規之污染整治管制措施致本府受有損害，申請人應賠償本府所受之一切損害。
- 六十六、申請人如為行政院環境保護署依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，應於買賣契約解除交還申購土地時，提供土壤污染檢測資料予本府，如未檢具前開土壤污染檢測資料而欲解除契約，應於買賣契約解除之日起 2 個月補正之。逾 2 個月仍未補正者，本府得委請第 3 人

檢測，並向申請人請求相關費用。

- 六十七、申請人未來建廠時應將土壤液化與不均勻沉陷等問題列入設計考量，並應依建築技術規則等相關法令規定辦理。
- 六十八、本園區土地(含產業用地退縮帶)內如有地下管線、地面人(手)孔、兩污水收集、邊坡擋土等公共(用)設施(備)之相關需求，申請人不得異議；其地面除作空地、綠地及通道外，不得構築建築物或加以破壞，本園區服務中心並得派員進入清理維護該等公共設施(備)、辦理污水採樣等作業，申請人不得拒絕。
- 六十九、申請人使用各項公共管線，除接戶線部分需自行洽各該事業主管機關辦理外，必要時並應無條件提供鄰地使用人共同使用接點。
- 七十、申請人應依產業創新條例第五十三條規定繳交下列各項維護費或使用費：
- (一) 一般公共設施維護費。
 - (二) 污水處理系統使用費。
 - (三) 其他特定設施之使用費或維護費。
- 七十一、申請人應依本園區環評書件所載之內容及審查結論切實執行，若有違反情事，致本府遭受主管機關裁罰，本府將追究申請人責任並據以求償。
- 七十二、配合現行環保法令或新公告法令規定，本府若需於承購土地設置環境監測設施，申請人應需配合本府要求不得拒絕。
- 七十三、其他法規如有規定者，申請人亦應遵守，不得違反。

【其他】

- 七十四、本要點規範之園區服務中心權責，於本園區服務中心成立前，由本府經濟發展局統籌辦理；本要點規範之合發公司權責，於本府與合發公司契約屆期後，由本府經濟發展局統籌辦理。
- 七十五、本府有增加、調整、變動或修改本要點內容之權利，如有其他未盡事宜，應依相關法令釋疑之。



圖例：EL14.4 坵塊之建築物一樓樓地板建議高程

附圖 和發產業園區各坵塊建議基地高程示意圖

附件 3-1 和發產業園區產業用地(二)容許引進產業類別

第二種產業專用區(產業用地(二))係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

- 一、住宿及餐飲業。
- 二、金融及保險業。
- 三、機電、管道及其他建築設備安裝業。
- 四、汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。
- 五、電信業。
- 六、本園區土地使用管制要點第四點第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。
- 七、其他教育服務業。
- 八、醫療保健服務業。
- 九、創作及藝術表演業。
- 十、連鎖便利商店。
- 十一、其他經中央主管機關核准之行業。

第二種產業專用區(產業用地(二))，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與本園區土地使用管制要點第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

本園區土地使用管制要點第四點第一項第六款所列行業，為企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

第二項所稱本園區土地使用管制要點第四點第一項所列行業，即為本園區產業用地(一)土地出(標)售手冊所容許之引進產業類別，細分為：

- 一、製造業：
 - (一) 金屬製品製造業 (25) ；
 - (一) 金屬製品製造業 (25) ；
 - (二) 電子零組件製造業 (26) ；
 - (三) 電腦、電子產品及光學製品製造業 (27) ；
 - (四) 電力設備製造業 (28) ，但不包含電池製造業 (282) ；

- (五) 機械設備製造業 (29) ；
- (六) 汽車及其零件製造業 (30) ；
- (七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31) 。
- (八) 食品及飼品製造業 (08)
- (九) 塑膠製品製造業 (22)
- (十) 家具製造業 (32)
- (十一) 其他製造業 (33)
- (十二) 玻璃及其製品製造業 (231) ；
- (十三) 其他經本府經發局核定之低污染製造業(係指單位面積污染需求量為園區平均值之 80% 以下之廠商)。

二、電力及燃氣供應業。

三、批發業(不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業)。

四、倉儲業(含儲配運輸物流)。

五、資訊及通訊傳播業(不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業)。

六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

七、污染整治業。

八、洗衣業(具中央工廠性質)。

除上開列舉之產業外，放射性工業(包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業)與專門從事表面處理之行業，不得進駐本園區。

附件 3-2 和發產業園區資源或污染物單位面積核配基準 (產業用地(二))

項目	單位	核配基準
用水量	CMD/公頃	16
污水量	CMD/公頃	12.8
用電量	KW/公頃	681
溫室氣體	公噸/年/公頃	5257
一般事業廢棄物	公噸/日/公頃	0.3096
有害事業廢棄物	公噸/日/公頃	0
空氣污染物	公噸/年/公頃	0

註一：空氣污染物除溫室氣體外，尚包含 PM2.5、PM10、TSP、Sox、NOx、CO、VOCs、硫酸、硝酸、鹽酸等，並依本園區最新核定之環境影響評估報告管制。

註二：申請量超過核配基準者應依本園區資源或污染物排放總量管理原則之規定辦理，並填寫相關計畫申請調撥，經核准後始得進駐。

註三：因事業廢棄物入區申請量為每年產生量，本園區係以每年 240 工作日計算每日產生量作為管制依據。

註四：申請人申請混合使用產業用地(一)所列行業時，核配基準由本府依本園區產業用地(一)出(標)售手冊之規定審查後核配，惟其他經本府經發局核定之低污染製造業不得申請調撥。

附件 3-3 和發產業園區危害性化學物質原料使用總量

種類	項次	中文名稱	英文名稱	運作量(公噸/年)
非致癌物	1	二丙二醇甲醚	Ethylene glycol monomethyl ether	2
	2	二氧化矽	Silicon dioxide	0.13
	3	錫	Tin	0.05
	4	銀	Silver	0.005
	5	銅	Copper	500
	6	甲醇	Methyl alcohol	0.05
	7	硝酸	Nitric acid	340
	8	丁酮	Methyl ethyl ketone	2
	9	硫酸	Sulfuric acid	550
	10	鹽酸	Hydrogen chloride	2100
	11	氯酸鈉	Sodium chlorate	190
	12	氫氧化鈉	Sodium hydroxide	3300
	13	焦磷酸四鈉	Tetrasodium pyro-phosphate	3
	14	乙二醇	Ethylene glycol	11
	15	過氧化氫	Hydrogen peroxide	50
	16	乙二醇丁醚	Ethylene glycol monobutyl ether	20
	17	乙炔	Acetylene	2
	18	丁烷	Butane	1
	19	乙酸正丁酯	n-Butyl acetate	0.51
	20	乙硫醇	Ethyl mercaptan	0.4
	21	酚	Phenol	1
	22	丙烷	Propane	1
	23	滑石	Talc	1
	24	二甲苯	Xylene	1
	25	氯化鋅	Zinc chloride	0.4
	26	戊烷	Pentane	去漬油內含有微量
	27	正庚烷	n-Heptane	去漬油內含有微量
	28	鋁	Alumina	0.5
	29	乙醇	Ethyl alcohol	1
總計(公噸/年)				7078.045
IARC Group 2B	1	碳黑	carbon black	1
	2	鈷化合物	cobalt compounds	11
	3	鎳	Nickel	25
	4	乙苯	Ethylbenzene	1
	5	二氧化鈦	Titanium dioxide	0.7
IARC Group 3	1	異丙醇	Isopropyl Alcohol	35
	2	甲苯	Toluene	0.5
統計(公噸/年)				74.2

附件 3-4 和發產業園區污水處理納管水質限值

編號	項目	納管限值	編號	項目	納管限值
1	水溫	45°C	35	飛佈達及其衍生物	不得檢出
2	pH 值	5~9	36	滴滴涕及其衍生物	不得檢出
3	硫化物	1.0 mg/L	37	阿特靈、地特靈	不得檢出
4	生化需氧量(BOD)	150 mg/L	38	五氯酚及其鹽類	不得檢出
5	化學需氧量(COD)	400 mg/L	39	毒殺芬	不得檢出
6	懸浮固體(SS)	250 mg/L	40	五氯硝苯	不得檢出
7	正己烷抽出物(油脂)	30 mg/L	41	福爾培	不得檢出
8	硒	0.35 mg/L	42	四氯丹	不得檢出
9	氰化物	1.0 mg/L	43	蓋普丹	不得檢出
10	總汞	0.005 mg/L	44	硝酸鹽氮	50 mg/L
11	甲基汞(有機汞)	不得檢出	45	真色色度	400 mg/L
12	鎘	0.02 mg/L	46	氨氮	50 mg/L
13	鉛	0.5 mg/L	47	油漆類	不得排入
14	總鉻	1.5 mg/L	48	動物羽毛	不得排入
15	六價鉻	0.17 mg/L	49	有毒物質	不得排入
16	砷	0.35 mg/L	50	易燃或爆炸性物質	不得排入
17	銅	1.5 mg/L	51	惡臭物	不得排入
18	鋅	3.5 mg/L	52	大型物體	不得排入
19	溶解性鐵	10.0 mg/L	53	錫	1.0 mg/L
20	溶解性錳	10.0 mg/L	54	銻	0.1 mg/L
21	鎳	0.1 mg/L	55	鎳	0.1 mg/L
22	甲醛	3.0 mg/L	56	鉬	0.6 mg/L
23	銀	0.5 mg/L	57	鈷	0.001 mg/L
24	陰離子界面活性劑	10 mg/L	58	鋁	0.63 mg/L
25	硼	1.0 mg/L	59	鉍	1.0 mg/L
26	酚類	5.0 mg/L	60	萘	0.009 mg/L
27	氰化物 (不包括複合離子)	15 mg/L	61	異丙醇	0.03 mg/L
28	多氯聯苯	不得檢出	62	乙醇胺	0.097 mg/L
29	總有機磷劑	0.5 mg/L	63	二乙醇胺	0.025 mg/L
30	總氮機甲酸鹽	0.5 mg/L	64	總毒性有機物	1.37 mg/L
31	除草劑	1 mg/L	65	鈾	10 mg/L
32	安殺番	不得檢出	66	鉍	0.5 mg/L
33	安特靈	不得檢出	67	鋰	2.5 mg/L
34	靈丹	不得檢出			

備註：本表數據僅供參考，應依本府公告之「高雄市和發產業園區下水道管理辦法」規定之納管限值為準。

附件 3-5 和發產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項

壹、規劃設計階段

一、公害污染防治

- 將「環境影響說明書(定稿本)」承諾事項及審查結論，納入相關工程契約書中，責成承包商落實工地環保工作。
- 研訂「營建工程逕流廢水污染削減計畫」，於施工前報請主管機關核備。
- 針對距計畫基地可能受施工噪音影響之敏感受體，規劃設置與地面密接之圍籬，若施工計畫需使用空壓機、發電機等易產生噪音設備時，放置地點應儘量避開敏感受體，無法避開時，則考量使用消音包覆或裝設消音器。
- 場址規劃設計階段，應將 LID(低衝擊開發)及 BMPs(降雨逕流非點源污染最佳管理技術)之觀念及做法納入考量，以降低非點源污染排放量。
- 前期進駐廠商污水排放，應排至應急設施工程(300 CMD)或排至大發工業區污水處理廠處理，以處理污水處理廠未完工前之污水。
- 研提「水污染防治措施計畫」送環保主管機關審核，並依「水污染防治法」提出放流水排放許可申請。
- 與高雄市環保局協商施工期間之工地廢棄物清運處理事宜。
- 將於開工前提報空氣污染防制計畫書(含污染防治設施經費)，送當地環保局同意後，始得開工。空氣污染防制計畫書內容應具體、量化，可供查核；項目應包含：工程基本資料、環境座落及場內設施平面配置圖說、施工期程圖說、砂石土方產生量、空氣污染物排放源及排放量、各施工項目依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行之防制設施(另增加監控設施)內容，包括設施種類、效能、流程、使用狀況及其設計圖說。

二、動植物生態維護

- 於施工契約或施工規範中規定承包商須遵守「野生動物保育法」，要求施工人員若發現保育類野生動物進入施工範圍時不得騷擾、虐待及獵捕，並訂定罰則

三、排水維護

- 於基地內規劃足夠容量之滯洪池，池基採透水底部設計，以調節計畫基地開發所增加之地表逕流，並於基地邊界規劃設置截流設施，避免影響周遭區域之排水。

四、動植物生態維護

- 計畫基地內綠地之栽種植種，除基地內既有留存移植之樹木外，不種植外來種，將選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物。採多物種、多層次之生態綠化原則進行植栽，包括上層大型喬木、中層小型灌木等，地面並密植草本植物，形成混生複層植被之良好綠地環境；此外，亦可栽植誘鳥植物及蜜源植物，引入生態園林之理念，以營造較適合之棲息環境，誘使施工期間避離之小型動物重新進入。

- 於施工契約或施工規範中規定承包商須遵守「野生動物保育法」，要求施工人員若發現保育類野生動物進入施工範圍時不得騷擾、虐待及獵捕，並訂定罰則。

貳、施工階段

一、工地防災

- 為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如砂包、木樁、繩索、塑膠布、草蓆、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。
- 承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區以合適之綠化工法覆蓋裸露面。
- 承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沈砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。
- 承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。
- 颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。
- 承包商須於施工現場附近樹立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。

二、水污染防治

- 依水污染防治法第 18 條暨「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 10 條規定，檢具逕流廢水削減計畫向主管機關申請核准，並據以實施。
- 承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統收集地表逕流廢水，並與既有排水系統銜接。
- 承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。
- 承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池，將施工及運輸車輛清洗所產生之泥水，處理至符合營造業放流水標準後再予放流。
- 承包商於工區設置工務所時，須設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，至符合建築物污水處理設施放流水標準（大腸桿菌群不得超過 300,000 CFU/100ml）後再行排放；或設置流動廁所並定期委託清運。
- 本計畫基地位屬高屏溪流域水污染管制區內，不得有水污染防治法第 30 條規定之行為。

三、空氣污染防制

- 依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」中第一級營建工程規定，於營建工地周界設置釘著地面之全阻隔式圍籬及防溢座，以及各項抑制粉塵措施。
 - a. 設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電

話及當地環保機關公害檢舉電話。

- b. 於工地周界設置 2.4 公尺高、釘著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。惟於道路轉角或轉彎處 10 公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬；周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。
 - c. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。
 - d. 工地內之車行徑路徑應鋪設鋼板、混凝土、瀝青、粗級配或及他同等工程之粒料，且鋪設範圍需達車行路徑面積之 80% 以上。
 - e. 針對工地內之裸露地表，應覆蓋防塵布或防塵網；或鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料；或植生綠化；或地表壓實且配合灑水措施；或定期灑水(至少每 4 小時乙次)。防制範圍應達裸露地面積之 80% 以上。
 - f. 於工地車行出入口，設置洗車台及沉砂池，並於洗車台四周設置防溢座或集水坑或其他防制措施，防止洗車廢水溢出工地。
 - g. 車輛離開工地前，應有效清洗車體及輪胎，其表面不得附著污泥。
 - h. 營建工地結構體施工架外緣應設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。
 - i. 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布或其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少 15 公分。
- 進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以防塵塑膠布或帆布覆蓋車體，防止土砂散落，必要時，需在車尾下方安裝泥水槽溝。
 - 道路路基填築滾壓作業之灑水須依填方材料土壤試驗結果控制灑水量以達最佳含水量及滾壓至符合所要求密度外。於工區出入口、骨材堆置面、傾卸作業區域及裸露地表，租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。
 - 於工區出口至洗車台間進行鋪面或鋪設鋼板，以減少車體塵土之附著並增加揚塵抑制效果。
 - 於鄰近聚落等敏感受體區域施工時，須設置與地面密合之圍籬。
 - 定期維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。
 - 每日進行基地聯外道路之清掃工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。
 - 施工期間將配合高雄市相關之空污計畫，針對施工車輛等交通工具，加強柴油抽測以及路邊攔檢，以降低空氣污染物之排放及提昇空氣品質。
 - 必要時將派員加強掃街以降低其背景濃度，亦會配合高雄市環保局之空氣污染防制（空氣污染管制策略及避免空氣品質惡化及緊急應變措施）辦理，以維護當地空氣品質。
 - 園區內公共工程未施作時，廠商應認養工地周邊道路(含施工及營運期間)，藉由洗掃方式，

將排放之粒狀物清除，以維持本案開發前之環境及空氣品質。認養道路以基地出入口兩側道路 500 公尺，清掃頻率為每日一次，將以本案推估之每年粒狀物排放量換算，並將記錄每次洗掃所去除之塵土量。進行道路洗掃時，洗掃作業參數及洗掃街車性能，將依環保署所訂「街道揚塵洗掃作業執行手冊」內容辦理。

- 園區內公共工程未施作時，廠商應於工地出入口設置自動洗車設備，洗淨土石運輸車輛，不得造成工地出入口及延伸之道路有色差及揚塵情形。自動洗車設備規格將依據環保署網站公告內容辦理。
- 園區內公共工程未施作時，廠商應於工地出入口設置錄影監視設備，監控土石運輸車輛清洗、覆蓋、路面污染及廢氣排放情形，並與當地環保局連線，及時監控。
- 將於堆置之土方、車行路徑及裸露區域全面覆蓋，或全面採取其他空氣污染防制設施，並以阻隔設施予以阻隔。
- 於傾卸工作區及裸露地表租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。
- 嚴格監督承包商，隨時清掃工區周界維持路面整潔。
- 避免施工機具及運輸車輛長時間處於空轉，以減少機具排氣所產生之空氣污染。

四、噪音振動防制

- 於工區周界進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，或有民眾陳情噪音將責成承包商更換或調整施工機具種類(如使用低噪音型機種、設置隔音罩及使用膠輪式機械)、數量(適當配置機械，避免同時操作)或重新安排施工時程，或採用較高之圍籬或使用隔吸音措施；針對可能受施工噪音影響之敏感受體，規劃設置密接地式圍籬等措施。
- 施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。
- 停止作業時間外之引擎轉動，限制引擎不必要之空轉等避免且減少噪音可能之產生。另因計畫基地距和春技術學院較近處主要為道路工程施作，影響時間約 1~2 個月，應將施工期程安排於長假期間(如暑假)，以降低施工期間影響。並避免夜間施工造成和春基地東南側住宅之作息影響。
- 施工期間將符合營建工程噪音管制標準，並符合日本之振動管制標準。
- 施工機具及運輸車輛需做定期保養，以維持良好運轉狀況。
- 正常施工時段原則以白天工作時間為原則，避免在夜間施工，造成附近居民影響。

五、廢棄物處理

- 監督承包商於施工所設置有蓋式垃圾桶收集生活垃圾，並委託當地清潔隊或廢棄物清除處理機構代為處理。
- 地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。

六、景觀環境維護

- 現況地表之有機表土將暫存於工區內，以供道路植栽帶、建築退縮帶及綠地回填使用。
- 施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。

七、道路交通維持

- 施工期間工區出入口，承包商視需要派員指揮交通。
- 將於承包商契約中明定，使用之施工及材料運輸車輛皆需符合現行「汽油車廢氣合格標準」及「柴油車排煙污染度合格標準」作為廢氣排放管制規定。
- 將於承包商契約中明定，使用之施工車輛及機具應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定，使用含硫量 10 ppmw 以下之合法油品。

九、睦鄰措施

- 承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。

十、文化資產維護

- 如有發現疑似遺址時，應依「文化資產保存法」第五十條及第五十一條之規定通報主管機關處理。
- 工程施工中若發現古物或文化遺址時，將立即停工，並依「文化資產保存法」之規定，報請主管機關處理。
- 本開發基地西側緊鄰鳳山丘陵一帶具有較密集文化資產分布，雖距開發基地尚有一段距離，本開發單位及相關單位仍將注意間接性及後續性發展之影響範圍，避免造成鄰近文化資產之影響。
- 由於本計畫基地西側緊鄰鳳山丘陵一帶具有較密集文化資產分布，因此本開發單位將不在此範圍內進行取土作業，避免造成鄰近文化資產之影響。
- 本計畫如發現疑似出土遺物、遺跡，將依文化資產保存法第 50 條規定：「營建工程或其他開發行為進行中，發現疑似遺址，應即停止工程或開發行為之進行，並報所在地主管機關」及同法第 51 條等規定辦理相關事宜。

十一、土方暫置場

廠商於園區內設有土方暫置場者，應實施下列防制措施：

- 土方除保留局部作業區外，其餘裸露面採用覆蓋防塵網、防塵布等措施，避免降雨期間雨水直接沖蝕造成土壤流失，且每隔數公尺以鋼條定入土中固定，以防止強風掀開。廠區非堆置區及車行路徑之裸露地表，將採臨時植生、稻草或其他適當逸塵措施，並定期清掃工區內及圍籬附近之塵土。另土方堆置區將施行適度灑水等措施，晴天每日以專用

灑水車進行多次防塵灑水作業，配合人工灑水方式補強。

- 土石方暫置採用階段式堆疊。另於堆置區邊坡將加設人車不可停駐警示牌，以維人員安全。
- 上述土石方暫置場環境保護措施承諾，要求施工單位廠商辦理。為確實遵依施作，將不定期進行查核確認，不合格者通知限期改善，必要時要求暫時停工，至改善為止。

參、營運階段

一、節約用水措施

- 利用滯洪池蓄積之雨水，供產業園區主要綠帶澆灌及清洗使用。
- 輔導區內公共建築及廠商採用省水設備（如小便器加裝電子感應器、使用省水型馬桶或水龍頭加裝曝氣器等），大型建物之屋頂設置雨水收集貯留設施，以回收供雜用水使用。

二、二氧化碳抵減措施

- 計畫產業園區內綠地應儘可能全面種樹，區內加強植栽綠化，進駐廠商法定空地應加強種植林木。進駐廠商法定空地綠化面積應符合入區申請內容，綠化面積及植栽數量非經市府核准，不得逕自縮減。
- 進駐廠商建築物建築面積為 1000 平方公尺以上者，屋頂 1/2 面積應設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。
- **廠商應增加回收廢熱、能源密度應進行規範、改善能源效率、進行能資源整合，使各廠進駐營運 10 年後，直接排放(燃料)減少 25%、間接排放(用電量)減少 15%。**
- 進駐廠商應儘量採用替代燃料或低碳燃料做為工業燃料。
- 進駐廠商應經由營運及製程管理方式降低能源消耗，強化工業減廢成效，進而減少二氧化碳排放。
- 進駐廠商之廠房針對照明、採光、用電系統應採省能設計，以降低能源消耗。
 - a. 空調省能措施：冷凍機以中央控制器管理分配調整、冷卻水加裝變頻器控制運轉、換氣改善、使用儲冰空調系統以降低尖峰用電、加強清洗及維護保養、廠房隔熱改善。
 - b. 照明系統省能措施：使用高功率安定器燈數、照明燈具採分區開關以使照明光源亮度依照度自動調整、照明使用合理化以去除過多燈管、廠房牆面及地板使用高反射率之顏色。
 - c. 電力系統省能措施：提昇低壓側功率因素、變壓器容量汰舊換新、提高設備使用電壓以降低線路損失、電力控制箱改為電力電子室控制。
 - d. 其他改善採行措施：定期檢查用電大之機器設備、減少空機運轉、全廠分區設電錶分析能源消耗量、自動化節能生產設備。
- 廠商應定期提報燃料及用電量等使用狀況，園區管理機構將依據廠商申請量進行定期查核，以確保廠商並未超出核定量，廠商進行減量時應同時檢討使用狀況。
- 單位面積需電量高於本園區平均值之進駐廠商，應進行溫室氣體盤查與登錄，並登錄於

國家溫室氣體登錄平台。

- 單位面積用電量較園區平均值高之廠商，廠商應提送溫室氣體抵減計畫，內容包含 BAT 之採用方式與減量效益等，市府將參考當時相關主管機關研擬之技術文件進行審查。
- 單位面積需電量高於本園區平均值之進駐廠商，應進行自行減量或抵換，減量或抵換量不足之部份，進駐廠商應透過碳抵換方式，例如購買先期專案或抵換專案環保署審查核發之減量額度。
- 廠商應定期申報燃料使用量及用電量予管理機構，若發現偏高或異常情形，管理機構將要求廠商進行減量並檢討使用狀況。
- 未來本產業園區將依據環保署溫室氣體管理(制)相關法規辦理，配合辦理園區溫室氣體管理及管制。
- 未來本府將要求本產業園區進駐廠商依據環保署溫室氣體管理(制)相關法規規定執行，並輔導廠商進行溫室氣體減量，倘廠商後續仍須進行溫室氣體(GHG)抵換作業，應依溫室氣體(GHG)減量及管理法相關法規辦理。如廠商後續依規定需進行溫室氣體抵換，將要求廠商以國內碳權之境內抵換為優先。

三、空氣污染防治與減量規劃

- 進駐廠商應依法採行環保署公告之各行業之最佳可行控制技術，並配合進行控制技術之改善。
- 進駐產業園區廠商應加強對污染防治設備操作人員之訓練，使其熟悉各種操作程序；加強生產操作程序控制，減少因設備異常或污染防治設備故障而排放大量污染物之機會。
- 進駐廠商應定期維護空污防制設備，確保維持正常狀態之運轉操作。
- 進駐廠商應進行清淨製程之檢討，逐步降低各污染物之排放量。
- 進駐廠商之所有車輛應符合最新一期車輛排放標準，以降低空污排放。
- 未來欲進駐本園區廠商若在高雄市原已有設廠且需申請空污排放許可者，需優先於舊廠自行減量，其減量額度亦可供本園區使用。

四、噪音振動防制

- 規範產業園區內各工廠依其噪音振動特性，規劃設計噪音振動防治設施，務必使各工廠周界之噪音量符合「工廠(場)噪音管制標準」。
- 易產生噪音之產業(如機械修配業等)應配置於距和春技術學院及東側住宅較遠之坵塊，以降低影響。
- 將進行監測，若發現有因本計畫工廠作業噪音導致有不符噪音管制標準，或民眾陳情噪音時，將要求廠商進行改善，覆檢後發現無法符合標準時，則於受影響側加裝隔音窗。

五、水污染防治

- 進駐廠商需遵守「水污染防治法」、「工業區下水道使用管理要點」及「工業區污水處理廠營運管理要點」等相關規定。
- 廠商建照申請時污染防治措施之審查、開工檢查、使用執照請領時之檢查、投資完成檢

查等，應同時設立環保專線及加強稽查，以確保污水排放水質。

- 進駐廠商污染申請情形應進行級別分類，並進行原料、製程之管控及污水排放巡查，並針對可能污染情形較高者進行不定期稽查。
- 廠商禁止於暴雨期間偷排污廢水至雨水下水道，園區管理機構將視雨水下水道水量狀況，進行園區廠商之污水排放稽查或以錄影設施進行監看。

六、廢棄物管理

- 各工廠應設置儲存區供一般廢棄物、化學溶劑及感染性廢棄物分類儲存之用。
- 配合環保署之工廠廢棄物申報系統網路資訊，各工廠應委託或自行處理之廢棄物種類、數量及處理方式。

七、景觀環境維護

- 各工廠不得恣意增建或改建廠房，俾免破壞產業園區整體景觀。

八、交通維持措施

- 駐廠商名下擁有之公務車輛於營運年採購時需符合當期之最新車輛排放標準。
- 鼓勵園區員工搭乘大眾運輸交通工具。

九、綠建築規劃

- 工廠類建築物，依「高雄市綠建築自治條例」第三條第三項及第六條規定，建築面積在一千平方公尺以上者依下列規定辦理：
 - a. 建築物屋頂應設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。設置面積應達新建最大建築面積二分之一以上。但屋頂不可設置區域得扣除之。
 - b. 建築物應全面採用省水便器。
- 後續配合最新發佈之「高雄市綠建築自治條例」辦理綠建築規劃。

十、健康風險評估

- 開發後健康風險總和不得超過本案針對高雄市大寮區、屏東縣萬丹鄉及 10×10 公里範圍內所有鄉鎮之預估健康風險總值。其中高雄市大寮區 95%UL 增量總致癌風險值上限為 5.94×10^{-7} ；屏東縣萬丹鄉 95%UL 增量總致癌風險值上限為 2.15×10^{-7} ；10×10 公里範圍內所有鄉鎮 95%UL 增量總致癌風險值上限為 3.51×10^{-7} 。若園區總量超過上限時，廠商應配合減量或採取其他相應措施。

十一、安全管理

- 廠商應依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」管制廠商內公共危險物品及可燃性高壓氣體之貯存，並藉以規範貯存場所數量要求、倉儲周圍空地保留及建築物防火構造。
- 廠商應依「危害辨識及風險評估技術指引」執行工作環境或作業危害之辨識、評估及控制、採購管理、承攬管理、變更管理與緊急應變措施等職業安全衛生事項。適用於須建立及執行緊急應變措施，以符合「職業安全衛生法」之要求。
- 園區未來將配合經濟部工業局要求參與工業區區域聯防，包括預防事故整備機制、緊急

事故通報機制、事故應變演練機制、應變支援機制等緊急應變對策。廠商應配合辦理。

- 本園區整體風險，有關化學品火災、氣體爆炸、粉塵外洩等風險，由於屬工廠安全管理範圍內，未來將列為公安檢查項目之一，並會藉由工安稽查時刻確保安全無虞，另本產業園區廠商進駐時有建蔽率及基地退縮等規定，廠商間應有安全帶以有效分隔，避免連鎖效應。廠商應配合辦理。

肆、其他應注意事項

- 一、依本府提供之「施工環境保護執行計畫」納入與承包商契約，作為施工期間執行環保工作之依據。
- 二、研擬「工地環境保護工作執行計畫」，於施工規範中應納入並明訂工地環保作業要點及罰則，並要求承包商據以提出工地環境保護工作執行計畫，送交工地工程司核可後實施。
- 三、應依本府提出之「營建工地逕流廢水污染削減計畫」內廠商應辦理事項辦理。
- 四、應依本府研擬之交通維持原則，納入工程合約中，依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」，依本府交通主管機關相關單位規定送審。
- 五、於工程合約中規定承包商及監工單位須指定專人負責環保工作之執行及現場監督、查核。
- 六、廠商提出設立申請時，應檢具緊急應變計畫及經相關主管機關核定之污染防治計畫書（至少包含水污染防治、空氣污染防制、噪音管制、廢棄物清理等），送產業園區管理機構核備。
- 七、配水及蓄水設施：為保障園區供水之穩定性，基地蓄水設施總容量擬考慮採平均日需水量3天規劃之，計畫於和春基地設置10,000噸配水池乙座，於大發基地設置7,000噸配水池乙座。並由廠商考量可承擔之缺水風險後自行設置1日以上用水量之蓄水設施，若用水量大於1000CMD者，應自行設置滿足三日用水量之蓄水設施。如再配合相關節約用水措施及缺水緊急應變措施，可使園區面臨缺水危機減至最低。
- 八、本園區引進產業設廠後，廠商應達成水利署「用水計畫書審查作業要點」相關用水量及回收率之建議值。
- 九、一般事業廢棄物適燃部份可送至南區資源回收廠，已協調該處資源回收廠同意代為處理。一般事業廢棄物不適燃部份須直接掩埋者，送至高雄市境內公民營廢棄物處理機構之掩埋設施處置。基地可能產生之有害事業廢棄物包括廢溶劑、污泥與廢液等，應由廠商自行清運或委託合法清除機構代為清運，並由廠商自行依環保法規辦理並申報。

陸、園區總量管制事項

- 一、廠商進駐後需配合園區污染總量管制，管制總量及單位面積核配基準如附件3-2及附件3-3。
- 二、本計畫符合健康風險評估技術規範定義之危害性化學物質之種類及原料使用量管制總

量參見附件 3-3，廠商於申請入區前應提出危害性化學物質運作種類及數量經本局或本工業區服務中心審核同意後始得進駐。

- 三、 廠商應依規定提出污染排放申請資料向服務中心辦理申請同意，始可檢附排放權同意文件向環保主管機關申請該類污染防治(制)措施設置許可。而環保局方面會針對本園區建立機制，本園區的申請案需檢附該同意文件才能同意該許可申請。若廠商要求空污排放量較核配基準高時，則應採行 BACT 後始核發排放量。
- 四、 配合高屏空品區總量管制示範計畫訂定之相關管制措施，未來行政院環境保護署公告各行業之最佳可行控制技術後，產業園區廠商均須配合進行控制技術之改善。
- 五、 配合空氣污染防制法之「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」，申請許可之廠家應提出申請，並確實執行許可之內容。
- 六、 廠商應每年提報實際污染量至服務中心，服務中心得依核准之核配量查核事業單位之污染排放情形，若有與核發排放量登載不符者，事業單位應提出污染排放量變更申請資料辦理變更。
- 七、 各進駐產業的排放限值未經本府或服務中心審查同意調整核配量，不得變更。
- 八、 廠商變更或展延空污許可證情況時，若檢討核配量有高於排放量情形，應重新檢討其核配量。
- 九、 廠商進駐後，應定期提報相關毒性化學物質使用狀況及相關 MSDS 物質資料表，以利查核。
- 十、 於廠商提出建廠申請時，應加強節水及綠建築省能設計。

柒、引進產業區位限制注意事項

- 一、 和春基地應將易產生噪音之產業(如機械修配業等)配置於距和春技術學院及東側住宅較遠之坵塊。
- 二、 和春基地於翁公園淨水場四周用地，應引進製程不需使用水、不需申請空氣污染排放許可及不使用毒性化學物質之廠商。

附件 3-6 危害性化學物質清單

填報注意事項：

1. 請提供正確使用物質之名稱(包括英文全名或化學式)
2. 若單一原料內含有多項危害性化學物質需逐項填列, 需填預計年使用重量(公噸/年), 勿填體積, 若非純物質, 請自行以百分比及比重換算
3. 所使用物質及數量請填寫於申購文件(九)污染防治說明書之危害性化學物質申報書清冊欄位內。
4. 依行政院環境保護署規定, 危害性化學物質指環保署、相關機關或國際環境保護公約公告或定期修正之最新清單所列者, 本附錄所列物質僅供參考, 申請人應自行查詢相關法令有無更新管制物質。
 - (1) 依下列環境保護及安全衛生法規所列之化學物質：
 - a. 毒性化學物質管理法公告之毒性化學物質。
 - b. 固定污染源空氣污染物排放標準及其他行業別空氣污染物排放標準所列之化學物質。但不包括燃燒設備排放之硫氧化物及氮氧化物。
 - c. 放流水標準所列之化學物質。
 - d. 有害事業廢棄物認定標準中製程有害事業廢棄物及毒性特性溶出程序 (TCLP) 溶出標準所列之化學物質。
 - e. 土壤污染管制標準所列之化學物質。
 - f. 地下水污染管制標準所列之化學物質。
 - g. 作業環境空氣中有害化學物質容許濃度標準所列之有害化學物質, 及勞工安全衛生法所稱危險物、有害物、有機溶劑、特定化學物質等。
 - (2) 依下列國際環境保護公約所規範之化學物質：
 - a. 斯德哥爾摩公約。
 - b. 蒙特婁議定書。
 - c. 其他國際環境保護公約。
 - (3) 依環保署環境影響評估審查委員會指定之其他有害化學物質。

英文全名/化學式	中文名稱
(一)毒性化學物質管理法規定之物質	
1,1,2,2-Tetrachloroethane	1,1,2,2-四氯乙烷
1,1-Dichloroethylene	1,1-二氯乙烯
1,2,3-Trichloropropane	1,2,3-三氯丙烷
1,2,4-Trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	鄰苯二甲酸二烷基酯 (C6-8 支鏈及直鏈, 富含 C7)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	鄰苯二甲酸二烷基酯 (C7-11 支鏈及直鏈)
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	二溴氯丙烷
1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)	1,2-二氯乙烷
1,2-Dichloroethylene	1,2-二氯乙烯
1,2-Dichloropropane	1,2-二氯丙烷
1,2-Diphenylhydrazine	1,2-二苯基聯胺
1,3-Butadiene	1,3-丁二烯
1,3-Dichlorobenzene	1,3-二氯苯
1,3-Dichloropropene	1,3-二氯丙烯
1,4-Dioxane	1,4-二氧陸園

英文全名/化學式	中文名稱
1-Naphthylamine	1-萘胺
2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175)	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚
2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE -183)	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚
2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153)	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚
2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154)	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚
2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)	2,2',4,4'-四溴二苯醚
2,4,5-Trichlorophenol	2,4,5-三氯酚
2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-三氯酚
2,4-Dichlorophenol	2,4-二氯酚
2,4-Dinitrophenol	2,4-二硝基酚
2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)	乙二醇乙醚
2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)	乙二醇甲醚
2-Naphthylamine	2-萘胺
2-Naphthylamine acetate	2-萘胺醋酸鹽
2-Naphthylamine Hydrochloride	2-萘胺鹽酸鹽
3,3'-Dichlorobenzidine	二氯聯苯胺
3,3'-Dimethoxybenzidine	二甲氧基聯苯胺
3,3'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine	鄰-二甲基聯苯胺
4,4'-Methylenedianiline	4,4'-二胺基二苯甲烷
4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT)	滴滴涕
4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A)	雙酚 A
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)	4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺)
4,6-Dinitro-o-cresol	4,6-二硝基-鄰-甲酚
Acetaldehyde	乙醛
Acetonitrile	乙腈
Acrolein	丙烯醛
Acrylamide	丙烯醯胺
Acrylonitrile	丙烯腈
Aldrin	阿特靈
Allyl alcohol	丙烯醇
Alpha (α) endosulfan	α -安殺番
Ammonium chromate	鉻酸銨
Ammonium dichromate	重鉻酸銨
Aniline	苯胺
Anthracene	蒽
Arsenic pentoxide	五氧化二砷
Arsenic trioxide	三氧化二砷
Asbestos	石棉
Barium chromate	鉻酸鋇
Benzene	苯
Benzidine	聯苯胺
Benzidine acetate	聯苯胺醋酸鹽

英文全名/化學式	中文名稱
Benzidine dihydrochloride	聯苯胺二鹽酸鹽
Benzidine dihydrofluoride	聯苯胺二氫氟酸鹽
Benzidine diperchlorate	聯苯胺二過氯酸鹽
Benzidine perchlorate	聯苯胺過氯酸鹽(一)
Benzidine perchlorate	聯苯胺過氯酸鹽(二)
Benzidine sulfate	聯苯胺硫酸鹽
Benzyl butyl phthalate (BBP)	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯
Benzyl chloride	苯甲氯
Beryllium	鈹
Beta (β) endosulfan	β-安殺番
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether	二氯異丙醚
Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (BEEP)	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯
Bis(2-methoxyethyl) phthalate (BMEP)	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯
Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate (BBEP)	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯
Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (BMPP)	鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯
Bis-Chloromethyl ether	二氯甲醚
Boron trifluoride	三氟化硼
Bromoform (Tribromomethane)	三溴甲烷(溴仿)
Butyl acrylate	丙烯酸丁酯
Butyraldehyde	丁醛
Cadmium	鎘
Cadmium carbonate	碳酸鎘
Cadmium chloride	氯化鎘
Cadmium cyanide	氰化鎘
Cadmium nitrate	硝酸鎘
Cadmium oxide	氧化鎘
Cadmium sulfate	硫酸鎘
Cadmium sulfide	硫化鎘
Calcium chromate	鉻酸鈣
Calcium cyanamide	氰胺化鈣
Calcium dichromate	重鉻酸鈣
Captafol	四氯丹
Captan	蓋普丹
Carbon disulfide	二硫化碳
Carbon tetrachloride	四氯化碳
Chlordane	可氯丹
Chlordecone	十氯酮
Chlorendic acid	六氯內-甲烯基-四氯苯二甲酸
Chlorine	氯
Chloroacetic acid	氯乙酸
Chlorobenzene	氯苯
Chlorobenzilate	克氯苯

英文全名/化學式	中文名稱
Chloroethane (Ethyl chloride)	氯乙烷
Chloroform	三氯甲烷
Chloromethane (Methyl chloride)	氯甲烷
Chloromethyl methyl ether	氯甲基甲基醚
Chloroprene	氯丁二烯
Chromated Copper Arsenate	鉻化砷酸銅
Chromium carbonyl	六羰化鉻
Chromium(VI) trioxide	三氧化鉻 (鉻酸)
Copper Sodium cyanide	氰化銅鈉
Copper(I) cyanide	氰化亞銅
Copper(I) potassium cyanide	氰化鉀銅
Copper(II) cyanide	氰化銅
Crotonaldehyde (2-butenal)	巴豆醛 (2-丁烯醛)
Cumene	異丙苯
Cupric chromate	鉻酸銅
Cupric dichromate	重鉻酸銅
Cyanazine	氰乃淨
Cyclohexane	環己烷
Cyhexatin	錫蟎丹
Daminozide	亞拉生長素
Decabromobiphenyl ether	十溴二苯醚
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
Dibenzofuran	二苯駢呋喃
Dibenzyl phthalate (DBZP)	鄰苯二甲酸二苄酯
Dibromomethane (Methylenebromide)	二溴甲烷
Dibutyl phthalate (DBP)	鄰苯二甲酸二丁酯
Dichlorobromomethane	二氯溴甲烷
Dichloromethane(Methylenechloride)	二氯甲烷
Dicyclohexyl Phthalate (DCHP)	鄰苯二甲酸二環己酯
Dicyclopentadiene	二環戊二烯
Dieldrin	地特靈
Diethanolamine	二乙醇胺
Diethyl phthalate (DEP)	鄰苯二甲酸二乙酯
Diethylamine, N-nitroso-(Nitrosamine diethyl)	N-亞硝二乙胺(二乙亞硝胺)
Di-iso-butyl Phthalate (DIBP)	鄰苯二甲酸二異丁酯
Di-isodecyl phthalate (DIDP)	鄰苯二甲酸二異癸酯
Di-isononyl phthalate (DINP)	鄰苯二甲酸二異壬酯
Di-iso-octyl Phthalate (DIOP)	鄰苯二甲酸二異辛酯
Dimethyl phthalate (DMP)	鄰苯二甲酸二甲酯
Dimethyl sulfate	硫酸二甲酯
Dimethylcarbamyl chloride	二甲基胺甲醯氯
Di-n-hexyl Phthalate (DNHP)	鄰苯二甲酸二己酯

英文全名/化學式	中文名稱
Di-n-nonyl phthalate (DNP)	鄰苯二甲酸二正壬酯
Di-n-octyl phthalate (DNOP)	鄰苯二甲酸二辛酯
Dinoseb	達諾殺
Di-n-pentyl Phthalate (DNPP)	鄰苯二甲酸二戊酯
Di-n-propyl Phthalate (DPP)	鄰苯二甲酸二丙酯
Diphenyl phthalate (DPP)	鄰苯二甲酸二苯酯
Diphenylamine	二苯胺
Endosulfan (Technical endosulfan)	安殺番
Endosulfan sulfate	安殺番硫酸鹽
Endrin	安特靈
Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane)	環氧氯丙烷
Ethyl chloroformate	氯甲酸乙酯
ethyl sulfate (Diethyl sulfate)	硫酸乙酯(硫酸二乙酯)
Ethylbenzene	乙苯
Ethylene dibromide	二溴乙烷(二溴乙烯)
Ethylene oxide	環氧乙烷
Ethyleneimine	次乙亞胺
Fenchlorphos	樂乃松
Ferric chromate	鉻酸鐵
Fluorine	氟
Folpet	福爾培
Formaldehyde	甲醛
Formamide	甲醯胺
Heptachlor	飛佈達
Hexabromobiphenyl	六溴聯苯
Hexachloro-1,3-butadiene	六氯-1,3-丁二烯
Hexachlorobenzene	六氯苯
Hexachlorocyclohexane	蟲必死
Hexachloroethane	六氯乙烷
Hexachloronaphthalene	六氯萘
Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane)	2,2'-二羥-3,3',5,5',6,6'-六氯二苯甲烷
Hexamethylphosphoramide (HMPA)	六甲基磷酸三胺
Hexyl 2-ethylhexyl phthalate (HEHP)	鄰苯二甲酸己基 2-乙基己基酯
Hydrazine	聯胺
Hydrogen cyanide	氰化氫
Lead chromate	鉻酸鉛
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)	鉬鉻紅
Lead chromate oxide	鉻酸氧鉛
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	硫鉻酸鉛
Leptophos	福賜松
Lindane (γ -BHC, or γ -HCH)	靈丹

英文全名/化學式	中文名稱
Lithium chromate	鉻酸鋰
Lithium dichromate	重鉻酸鋰
Lithium perfluorooctane sulfonate	全氟辛烷磺酸鋰鹽
m-Aminotoluene	間-甲苯胺
m-Cresol	間-甲酚
Mercuric dichromate	重鉻酸汞
Mercury	汞
Methyl hydrazine	甲基聯胺
Methyl iodide	碘甲烷
Methyl isobutyl ketone	甲基異丁酮
Methyl isocyanate	異氰酸甲酯
Methylmercury	甲基汞
Methyl-tert-butyl ether	甲基第三丁基醚
Mirex	滅蟻樂
Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)	鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯
Monofluoroacetamide	氟乙醯胺
Mono-n-Butyl phthalate (MNBP)	鄰苯二甲酸單丁酯
m-Toluylenediamine(m-Tolylene-diamine ; toluene- 2,4-diamine)	2,4-甲苯二胺
N,N-Dimethyl formamide	二甲基甲醯胺
Nickel carbonyl	四羰化鎳
Nitrilotri acetic acid	三乙酸基氮
Nitrobenzene	硝苯
Nitrofen	護谷
Nitrosodimethylamine (DMNA)	N-亞硝二甲胺(二甲亞硝胺)
N-Nitroso-N-methylurea	N-亞硝-正-甲脲
Nonylphenol	壬基酚
Nonylphenol polyethylene glycol ether	壬基酚聚乙氧基醇
o-Aminotoluene	鄰-甲苯胺
Octabromodiphenyl ether	八溴二苯醚
Octachloronaphthalene	八氯萘
o-Dichlorobenzene (1,2-Dichloro benzene)	鄰-二氯苯
P-Aminobiphenyl	對-胺基聯苯
P-Aminobiphenyl Hydrochloride	對-胺基聯苯鹽酸鹽
p-Aminotoluene	對-甲苯胺
p-Chloro-o-toluidine	對-氯-鄰-甲苯胺
Pentabromodiphenyl ether	五溴二苯醚
Pentachlorobenzene	五氯苯
Pentachloronitrobenzene	五氯硝苯
Pentachlorophenol	五氯酚
Perfluorooctane sulfonic acid	全氟辛烷磺酸
Perfluorooctane sulfonyl fluoride	全氟辛烷磺醯氟

英文全名/化學式	中文名稱
Phosgene	光氣
Phosphine	磷化氫
Phosphorus trichloride	三氯化磷
Phthalic anhydride	鄰苯二甲酐
P-Nitrobiphenyl	對-硝基聯苯
Polychlorinated biphenyls	多氯聯苯
Potassium chromate	鉻酸鉀
Potassium cyanide	氰化鉀
Potassium dichromate	重鉻酸鉀
Propane sultone	1,3-丙烷磺內酯
Propargyl alcohol	炔丙醇(2-丙炔-1-醇)
Propyleneimine	丙烯亞胺
Pyridine	吡啶
Silver chromate	鉻酸銀
Silver cyanide	氰化銀
Sodium chromate	鉻酸鈉
Sodium cyanide	氰化鈉
Sodium dichromate	重鉻酸鈉
Sodium pentachlorophenate	五氯酚鈉
Stannic chromate	鉻酸錫
Strontium chromate	鉻酸鋇
Styrene oxide	氧化苯乙烯
Tetrachloroethylene	四氯乙烯
Thiosemicarbazide 1-amino-2-thiourea	胺基硫脲
Thiourea (thiocarbamide)	硫脲
Toluene diisocyanate (mixed isomers)	二異氰酸甲苯
Toluene-2,4-diisocyanate	2,4-二異氰酸甲苯
Toluylenediamines(mixed isomers) ; (toluene,diamino-) (mixed isomers)	甲苯二胺(同分異構物混合物)
Toxaphene	毒殺芬
Tributyltin acetate	醋酸三丁錫
Tributyltin bromide	溴化三丁錫
Tributyltin chloride	氯化三丁錫
Tributyltin fluoride	氟化三丁錫
Tributyltin hydride	氫化三丁錫
Tributyltin laurate	月桂酸三丁錫
Tributyltin maleate	順丁烯二酸三丁錫
Tributyltin oxide Bis(tributyltin)oxide	氧化三丁錫
Trichloroethylene	三氯乙烯
Trichloromethyl benzene	三氯甲苯
Triethylamine	三乙胺
Trinickel disulfide	次硫化鎳

英文全名/化學式	中文名稱
Tri-n-propylethyltin	三正丙基乙錫
Tri-n-propylisobutyltin	三正丙基異丁錫
Tri-n-propyl-n-butyltin	三正丙基正丁錫
Tri-n-propyltin iodide	碘化三正丙錫
Triphenylbenzyltin	三苯基苄錫
Triphenylmethyltin	三苯基甲錫
Triphenyl-p-tolyltin	三苯基-對-甲苯錫
Triphenyltin acetate	醋酸三苯錫
Triphenyltin bromide	溴化三苯錫
Triphenyltin chloride	氯化三苯錫
Triphenyltin fluoride	氟化三苯錫
Triphenyltin hydroxide	氫氧化三苯錫
Triphenyltin iodide	碘化三苯錫
Triphenyl- α -naphthyltin	三苯基- α -萘錫
Tripropyltin bromide	溴化三丙錫
Tripropyltin chloride	氯化三丙錫
Tripropyltin fluoride	氟化三丙錫
Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate	三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯
Tris(2-chloroethyl) phosphate(TCEP)	三 2-(氯乙基)磷酸酯
Tritolyltin bromide	溴化三甲苯錫
Tritolyltin chloride	氯化三甲苯錫
Tritolyltin fluoride	氟化三甲苯錫
Tritolyltin hydroxide	氫氧化三甲苯錫
Tritolyltin iodide	碘化三甲苯錫
Trisphenylstannyl-methane	參(三苯錫)甲烷
Trixylyltin bromide	溴化三苐錫
Trixylyltin chloride	氯化三苐錫
Trixylyltin fluoride	氟化三苐錫
Trixylyltin iodide	碘化三苐錫
Vinyl acetate	醋酸乙烯酯
Vinyl bromide	溴乙烯
Vinyl Chloride	氯乙烯
Zinc chromate (Zinc chromate hydroxide)	鉻酸鋅 (鉻酸鋅氫氧化合物)
Zinc cyanide	氰化鋅
Zinc dichromate	重鉻酸鋅
α -Bromobenzyl cyanide	α -氟溴甲苯
α -Chloroacetophenone (w-Chloroacetophenone)	α -苯氯乙酮 (w-苯氯乙酮)
β -Propiolactone	β -丙內酯
(二)其他法令規定之危害性化學物質	
Acenaphthalene	芴烯
Acetic acid	醋酸
Acetic anhydride	乙酸酐

英文全名/化學式	中文名稱
Acetone	丙酮
Acetylene	乙炔
Acetylene tetrabromide	四溴化乙炔 (1,1,2,2-四溴乙烷)
Acrylic acid	丙烯酸
Alachlor	拉草
Allyl chloride	氯丙烯
Allyl glycidyl ether (AGE)	丙烯基縮水甘油醚
Aluminum	鋁
4-Aminodiphenyl	4-胺基聯苯
2-Aminopyridine	2-胺吡啶
Ammonia	氨
Ammonium chloride	氯化氨
Ammonium nitrate	硝酸銨
Ammonium perchlorate	過氯酸銨
Amosite	褐石綿
Amyl acetate	乙酸戊酯
n-Amyl acetate	乙酸正戊酯
o-Anisidine	鄰-甲氧苯胺
Antimony	銻
ANTU (α -Naphthyl thiourea)	安妥 (α -萘硫脲)
Arsenic	砷
Arsine	砷化氫
Auramine	奧黃
Azinphos methyl	谷速松
Barium	鋇
Barium peroxide	過氧化鋇
Benomyl	免賴得
Benzo(a) anthracene	苯(a)駢蒽
Benzo(a) pyrene	苯(a)芘
Benzo(b) fluoranthene	苯(b)二苯駢
Benzoyl peroxide	過氧苯醯
Benzoyl peroxide	過氧化二苯甲醯
Benzyl chloride	氯化甲基苯
Biphenyl	聯苯
Bipyridyl (Bipyridine)	聯吡啶
Bis-2-chloroethyl ethers	2-氯乙醚
Boron	硼
Boron tribromide	三溴化硼
Bromine	溴
Bromine pentafluoride	五氟化溴
Butachlor (n-butoxymethyl-2-chloro-2, 6-diethylacetanilide)	丁基拉草
Butadiene	丁二烯

英文全名/化學式	中文名稱
Butane	丁烷
1-Butanol	1-丁醇
2-Butanol	2-丁醇
1-Butanethiol	1-丁硫醇
Butyl acetate	乙酸丁酯
n-Butyl acetate	乙酸正丁酯
n-Butyl lactate	乳酸正丁酯
Butylamine	丁胺
o-sec-Butyl phenol	鄰-第二丁酚
n-Butyl glycidyl ether (BGE)	正丁基縮水甘油醚
Calcium arsenate	砷酸鈣
Calcium carbide	碳化鈣
Calcium hydroxide	氫氧化鈣
Calcium hypochlorite	次氯酸鈣
Calcium oxide	氧化鈣
Calcium phosphide	磷化鈣
Camphor (Synthetic)	合成樟腦
Caprolactam	己內醯胺
Carbaryl	加保利
Carbendazim	貝芬替
Carbofuran	加保扶
Carbon black	碳黑
Carbon dioxide	二氧化碳
Carbon monoxide	一氧化碳
Carbosulfan	丁基加保扶
Cesium hydroxide	氫氧化銫
Chlorinated diphenyl oxide	氯化氯二苯
Chlorine dioxide	二氧化氯
Chlorine trifluoride	三氟化氯
Chloro acetaldehyde	一氯乙醛
2-Chloro-1,3-butadiene	2-氯-1,3-丁二烯
Chloro difluoro methane	氯二氟甲烷
1-Chloro-2,3-epoxy propane	1-氯-2,3-環氧丙烷
Chloro pentafluoro ethane	氯五氟乙烷
Chloro picrin (Trichloro nitromethane)	氯化苦 (三氯硝甲烷)
Chloroacetaldehyde	氯乙醛
Chloroacetyl chloride	氯乙醯氯
Chlorobromomethane	溴氯甲烷
2-Chloro ethanol	2-氯乙醇
Chloromethane	氯化甲烷
1-Chloro-1-nitropropane	1-氯-1-硝基丙烷
o-Chlorostyrene	鄰-氯苯乙烯

英文全名/化學式	中文名稱
o-Chlorotoluene	鄰-氯甲苯
Chromium	鉻
Chrysene	屈
cis-1,2-Dichloroethylene	順-1,2-二氯乙烯
Cobalt	鈷
Copper	銅
Creosote	木榴油
Cresol	甲酚
Crocidolite	青石棉
Cyanamide	氰胺 (氰滿素)
Cyclo hexanone	環己酮
Cyclohexanol	環己醇
Cyclohexylamine	環己胺
1,3-Cyclopentadiene	1,3 環戊二烯
Cyclopentane	環戊烷
Decaborane	十硼烷
Demeton	滅賜松
Diacetone alcohol	二丙酮醇
Diazinon	大利松
Diazodinitrophenol	重氮基酚
Diazomethane	重氮甲烷
Dibenzo(a)anthracene	二苯駢(a)駢蔥
Diborane	二硼烷
Dibutyl phosphate	磷酸二丁酯
Dicalcium Phosphate	磷酸二鈣
Dichloro acetylene	二氯乙炔
Dichloro difluoro methane	二氯二氟甲烷
Dichloro monofluoro methane	二氯氟甲烷
2,2-Dichloro propionic acid	2,2-二氯丙酸
Dichloro tetrafluoro ethane	對-四氟二氯乙烷
Dichlorobenzene	二氯苯
1,4-Dichlorobenzene	1,4-二氯苯
3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenylmethane (Diaminodiphenylmethane)	3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷
1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin	1,3-二氯-5,5-二甲基乙內醯
1,1-Dichloro ethane	1,1-二氯乙烷
trans-1,2-Dichloroethylene	反-1,2-二氯乙烯
Dichloroethyl ether	二氯乙醚
Dichloropropanol	二氯丙醇
Dichlorotetrafluoroethane	四氟二氯乙烷
Dichromic acid	重鉻酸
1,1-Dichloro-1-nitroethane	1,1-二氯-1-硝基乙烷

英文全名/化學式	中文名稱
2,6-Dichlorophenol	2,6-二氯酚
2,4-D (2,4-Dichloro phenoxy acetic acid)	2,4-地 (2,4-二氯苯氧乙酸)
Dicrotophos	雙特松
2-Diethyl amino ethanol	2-二乙胺基乙醇
Diethyl ketone	二乙酮
Diethyl phthalate	鄰-苯二甲酸二乙酯
Diethylamine	二乙胺
Diethylene triamine	二次乙基三胺
Difluoro dibromo methane	二溴二氟甲烷
Diglycidyl ether (DGE)	縮水甘油醚
Diisobutyl ketone	二異丁酮
Diisopropyl amine	二異丙胺
N,N-Dimethyl acetamide	N,N-二甲基乙醯胺
N,N-Dimethyl aniline	N,N-二甲基苯胺
Dimethyl dichloro vinyl phosphate (DDVP)	二氯松
Dimethyl disulfide	二硫化甲基
1,1-dimethylhydrazine (UDMH)	1,1-二甲基聯胺
Dimethyl sulfate	二甲基硫酸鹽
Dimethyl sulfide	硫化甲基
Dimethylamine	二甲胺
Dinitro benzene	二硝基苯
m-dinitrobenzene	間-二硝基苯
Dinitroethyleneglycol	二硝基乙二醇
Dinitrotoluene	二硝基甲苯
2,4-Dinitrotoluene	2,4-二硝基甲苯
Dioxathion	大克松
Dipropyl ketone	二丙酮
Dipropylene glycol methyl ether	二丙二醇甲醚
Disulfoton	二硫松
Divinyl benzene (DVB)	二乙烯苯
Epichlorohydrin	3-氯-1,2-環氧丙烷
EPN	一品松
1,2-Epoxypropane	1,2-環氧丙烷
2,3-Epoxy-1- propanol (Glycidol)	2,3-環氧丙醇
Ethane	乙烷
Ethanolamine	乙醇胺
Ethene	乙烯
Ethion	愛殺松
Ethyl acetate	乙酸乙酯
Ethyl acrylate	丙烯酸乙酯
Ethyl alcohol	乙醇
Ethyl amyl ketone	乙基正戊酮

英文全名/化學式	中文名稱
Ethyl bromide	溴乙烷
Ethyl butyl ketone	乙基丁基酮
Ethyl ether	乙醚
Ethyl formate	甲酸乙酯
Ethyl mercaptan	乙硫醇
Ethyl mercury	乙基汞
Ethylamine	乙胺
Ethylene diamine	乙二胺
Ethylene glycol	乙二醇
Ethylene glycol monobutyl ether	乙二醇丁醚
Ethylene glycol monoethyl ether acetate	乙二醇乙醚醋酸酯
Ethylene glycol monomethyl ether acetate	乙二醇甲醚醋酸酯
Ethylene thiourea	乙硫脲
4-Ethylmorpholine	N-乙基-1,4-氧氮陸園
Ferro vanadium	釩亞鐵合金
Fluoranthene	苯駢芴
Fluoro trichloromethane	氟三氯甲烷
Formic acid	甲酸
Furfural	呋喃甲醛
Furfuryl alcohol	2-呋喃甲醇
Germanium tetrahydride	四氫化鍺
Glutaraldehyde	戊二醛
Glyphosate (n-(phosphonomethyl) glycine)	嘉磷塞
Hafnium	鈹
n-Heptane	正庚烷
Hexachloro butadiene	六氯丁二烯
Hexachloro cyclopentadiene	六氯環戊二烯
Hexafluoro acetone	六氟丙酮
Hexamethylene diisocyanate (HDI)	二異氰酸環己烷
Hexane	己烷
n-Hexane	正己烷
Hexylene glycol	2-甲基-2,4-戊二醇
Hydrocyanic acid	氫氰酸
Hydrogen	氫
Hydrogen bromide	溴化氫
Hydrogen chloride	氯化氫
Hydrogen fluoride	氟化氫
Hydrogen peroxide	過氧化氫
Hydrogen selenide	硒化氫
Hydrogen sulfide	硫化氫
Hydroquinone	氫醌(苯二酚)
Indeno(1,2,3-cd) pyrene	茚酮(1,2,3-cd)芘

英文全名/化學式	中文名稱
Indium	銻
Iodine	碘
Iron oxide	氧化鐵
Iron penta carbonyl	五羰鐵
Isoamyl acetate	乙酸異戊酯
Isoamyl alcohol	異戊醇
Isobutyl acetate	乙酸異丁酯
Isobutyl alcohol	異丁醇
Isooctyl alcohol	異辛醇
Isophorone	異佛爾酮
Isophorone diisocyanate (IPDI)	二異氰酸異佛爾酮
2-Isopropoxy ethanol	2-異丙氧基乙醇
Isopropyl acetate	乙酸異丙酯
Isopropyl alcohol	異丙醇
n-Isopropyl aniline	異丙基苯胺
Isopropyl ether	異丙醚
Isopropyl glycidyl ether (IGE)	異丙基縮水甘油醚
Isopropylamine	異丙胺
Ketene	乙烯酮
Lead	鉛
Lead arsenate	砷酸鉛
Lead Azide	疊氮化鉛
Lead Styphnate	史蒂芬酸鉛
Linen	亞麻
Lithium	鋰
Lithium hydride	氫化鋰
Magenta	苯胺紅
Magnesium	鎂
Magnesium oxide	氧化鎂
Malathion	馬拉松
Maleic anhydride	順-丁烯二酐
Manganese	錳
Manganese cyclo pentadienyl tricarbonyl	碳三羧基戊基錳
Mercuric Fulminate	雷汞
Mesityl oxide	異亞丙基丙酮
Methacrylic acid	甲基丙烯酸
Methamidophos	達馬松
4-Methoxy phenol	4-甲氧苯酚
Methyl 2-cyanoacrylate	2-氰基丙烯酸甲酯
Methyl acetate	乙酸甲酯
Methyl acetylene	丙炔
Methyl acrylate	丙烯酸甲酯

英文全名/化學式	中文名稱
Methyl acrylonitrile	甲基丙烯腈
Methyl alcohol	甲醇
N-Methyl aniline	N-甲苯胺
Methyl bromide	甲基溴化物
Methyl butyl ketone	甲丁酮
Methyl cyclo hexanone	甲基環己酮
Methyl cyclo pentadienyl manganese tricarbonyl	甲基環戊二烯三羰基錳
Methyl cyclohexane	甲基環己烷
Methyl cyclohexanol	甲基環己醇
Methyl ethyl ketone	丁酮
Methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO)	過氧化丁酮
Methyl formate	甲酸甲酯
Methyl isoamyl ketone	甲基異戊酮
Methyl isobutyl carbinol	4-甲基-2-戊醇
Methyl isopropyl ketone	甲基異丙酮
Methyl mercaptan	甲硫醇
Methyl methacrylate	甲基丙烯酸甲酯
Methyl n-amyl ketone	甲基正戊酮
Methyl parathion	甲基巴拉松
Methyl propyl ketone	甲丙酮
α -Methyl styrene	α -甲基苯乙烯
Methylal	二甲氧甲烷
Methylamine	甲胺
Methylene bisphenyl diisocyanate (Methylene bisphenyl isocyanate)	4,4-二異氰酸二苯甲烷
Methylene chloride	氯化次甲基
Mineral spirit (Mineral thinner , petroleum spirit , white spirit)	礦油精
Molybdenum	鉬
Monomethyl amine	一甲胺
Morpholine	1,4-氧氮陸園 (嗎啉)
Naphtha (Coal tar)	石油精
Naphthalene	萘
Nickel	鎳
Nicotine	菸鹼
Nitric acid	硝酸
Nitric oxide	一氧化氮
p-Nitroaniline	對-硝苯胺
p-Nitrochlorobenzene	對-硝基氯苯
4-Nitro diphenyl	4-硝基聯苯
Nitroethane	硝基乙烷
Nitrogen dioxide	二氧化氮

英文全名/化學式	中文名稱
Nitrogen trifluoride	三氟化氮
Nitroglycerin	硝化甘油
Nitroglycol	硝化乙二醇
Nitromethane	硝基甲烷
1-Nitropropane	1-硝基丙烷
2-Nitropropane	2-硝基丙烷
Nitrotoluene	硝基甲苯
Nonane	壬烷
Octane	辛烷
Osmium tetroxide	四氧化銱
Oxalic acid	草酸
Oxygen difluoride	氟化氧
Ozone	臭氧
p-Anisidine	對-甲氧苯胺
Paraldehyde	三聚乙醛
Paraquat	巴拉刈
Parathion	巴拉松
PCDDs/PCDFs	戴奧辛化合物
p-Dimethylaminoazobenzene	對-二甲胺基偶氮苯
Pentaborane	五硼烷
Pentachloro naphthalene	五氯萘
Pentachloronaphthalene	五氯化萘
Pentane	戊烷
Perchloro methyl mercaptan	過氯甲基硫醇
Perchloryl fluoride	過氯酸氟
Peroxyacetic acid	過醋酸
Petroleum benzine	輕油精
Petroleum ether	石油醚
Pheno thiazine	分塞嗪
Phenol	酚
Phenyl ether	苯醚
Phenyl glycidyl ether (PGE)	苯基縮水甘油醚
Phenyl hydrazine	苯肼
Phenyl mercaptan	苯硫醇
Phenyl phosphine	苯膦
Phenylenediamine	苯二胺
Phenylethane	苯乙烷
Phorate	福瑞松
Phosdrin (Mevinphos)	美文松
Phosphoric acid	磷酸
Phosphorodithioic	二硫磷酸
Phosphorothioic acid esters	硫磷酸酯類

英文全名/化學式	中文名稱
Phosphorus	磷
Phosphorus oxychloride	氧氯化磷
Phosphorus pentachloride	五氯化磷
Phosphorus pentasulfide	五硫化磷
Phthalodinitrile	二腈苯
o-Phthalodinitrile	鄰-二腈苯
2-Picoline	2-皮考林
Picric acid (Trinitrophenol)	苦味酸 (三硝基酚)
Piperazine dihydrochloride	二氫氯化六氫吡啶
Platinum Metal	鉑
p-Nitro chloro benzene	對-硝基氯苯
Polyurethane	聚氨基甲酸酯
Potassium	鉀
Potassium chlorate	氯酸鉀
Potassium nitrate	硝酸鉀
Potassium perchlorate	過氯酸鉀
Potassium peroxide	過氧化鉀
p-Phenylene diamine	對-苯二胺
Propane	丙烷
1-Propanol	1-丙醇
Propionic acid	丙酸
n-Propyl acetate	乙酸丙酯
n-Propyl nitrate (NPN)	硝酸丙酯
Propylene glycol dinitrate	丙二醇二硝酸酯
Propylene glycol monomethyl ether	丙二醇甲醚
Pyrethrum	除蟲菊
Quinone	醌
Resorcinol	間-苯二酚 (雷瑣辛)
Rhodium	銻
Rotenone	魚藤精
sec-Amyl acetate	乙酸第二戊酯
sec-Butyl acetate	乙酸第二丁酯
sec-Hexyl acetate	乙酸第二己酯
Selenium	硒
Selenium hexafluoride	六氟化硒
Silicon dioxide	二氧化矽
Silicon hydride (Silane)	四氫化矽
Silver	銀
Sodium	鈉
Sodium azide	疊氮化鈉
Sodium bisulfite	亞硫酸氫鈉
Sodium chlorate	氯酸鈉

英文全名/化學式	中文名稱
Sodium chlorite	亞氯酸鈉
Sodium dithionite	二亞硫磺酸鈉
Sodium fluoro acetate	氟乙酸鈉
Sodium hydroxide	氫氧化鈉
Sodium nitrate	硝酸鈉
Sodium perchlorate	過氯酸鈉
Sodium peroxide	過氧化鈉
Sodium Tripoly Phosphate	三聚磷酸鈉
Stibine (antimony hydride)	氫化銻
Stoddard solvent (White spirits)	斯多德爾溶劑
Styrene	苯乙烯
Sulfide	硫化物
Sulfur dioxide	二氧化硫
Sulfur hexafluoride	六氟化硫
Sulfur monochloride	一氯化硫
Sulfur pentafluoride	五氟化硫
Sulfur tetrafluoride	四氟化硫
Sulfuric acid	硫酸
Sulfuryl fluoride	氟化硫醯
Talc	滑石
Tantalum	鉭
Tellurium	碲
TEPP	帖普
Terphenyls	聯三苯
tert-Butyl acetate	乙酸第三丁酯
tert-Butyl alcohol	第三丁醇
p-tert-Butyl toluene	對-第三丁基甲苯
1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoro ethane	1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2- difluoro ethane	1,1,2,2-四氯-1,2-二氟乙烷
Tetra hydrofuran (THF)	四氫呋喃
Tetra methyl ammonium- hydroxide	氫氧化四甲銨
Tetra methyl lead	四甲基鉛
Tetrachloro naphthalene	四氯萘
Tetrachlorobenzene	四氯苯
Tetraethyl lead	四乙基鉛
Tetramethyl succinonitrile	四甲基琥珀腈
Tetranitro methane	四硝甲烷
Tetrasodium pyro-phosphate	焦磷酸四鈉
Thioglycollic acid	乙硫醇酸
Thiols	硫醇
Thionyl chloride	氯化亞硫醯
Thiram	得恩地

英文全名/化學式	中文名稱
Tin	錫
Tin oxide	氧化錫
Titanium dioxide	二氧化鈦
Titanium tetrachloride	四氯化鈦
Toluene	甲苯
Toluene-2,4-diamine	2,4-二胺甲苯
Toluene-2,6-diisocyanate (TDI)	2,6-二異氰酸甲苯
2,4,6-Tribromophenol	2,4,6-三溴酚
Tributyl phosphate (TBP)	磷酸三丁酯
Trichloro acetic acid (TCA)	三氯乙酸
1,1,1-Trichloro ethane (methyl chloroform)	1,1,1-三氯乙烷
1,1,2-Trichloro ethane	1,1,2-三氯乙烷
Trichloro naphthalene	三氯萘
Trichlorobenzene	三氯苯
Trichloroethane	三氯乙烷
Trichloropropane	三氯丙烷
1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoro ethane	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷
Trifluoro bromomethane	三氟溴甲烷
Trimellitic anhydride	1,2,4-苯三甲酸酐
Trimethyl benzene	三甲苯
Trimethyl phosphite	亞磷酸三甲酯
Trimethylamine	三甲胺
Trinitrobenzene	三硝基苯
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	2,4,6-三硝基甲苯
Triorthocresyl phosphate (TOCP)	三鄰甲苯基磷酸酯
Triphenyl amine	三苯基胺
Triphenyl phosphate	磷酸三苯酯
Tungstene	鎢
Turpentine	松節油
Uranium	鈾
n-Valeraldehyde	戊醛
Vanadium Pentaoxide	五氧化二釩
Vinyl cyclohexene dioxide	二氧化環己烯乙烯
Vinyl toluene	乙烯基甲苯
Warfarin	殺鼠靈
Xylene	二甲苯
Xylidine	二甲苯胺
Yttrium	鈮
Zinc	鋅
Zinc chloride	氯化鋅
Zinc oxide	氧化鋅
Ziram	二甲基二硫氨基甲酸鋅

英文全名/化學式	中文名稱
Bromochloromethane	一氟一溴甲烷
CFC-11	一氟三氯甲烷
CFC-111	一氟五氯乙烷
CFC-112	二氟四氯乙烷
CFC-113	三氟三氯乙烷
CFC-114	四氟二氯乙烷
CFC-115	五氟一氯乙烷
CFC-12	二氟三氯甲烷
CFC-13	三氟一氯甲烷
CFC-211	一氟七氯丙烷
CFC-212	二氟六氯丙烷
CFC-213	三氟五氯丙烷
CFC-214	四氟四氯丙烷
CFC-215	五氟三氯丙烷
CFC-216	六氟二氯丙烷
CFC-217	七氟一氯丙烷
Chlordecone	十氯酮 (克敵康)
4,4-Dichlorodiphenyl-triichloroethane (DDT)	二氯二苯基三氯乙烷 (滴滴涕)
Halon-1211	二氟一氯一溴甲烷
Halon-1301	三氟一溴甲烷
Halon-2402	四氟二溴乙烷
HBFC-121B4	一氟四溴乙烷
HBFC-122B3	二氟三溴乙烷
HBFC-123B2	三氟二溴乙烷
HBFC-124B1	四氟一溴乙烷
HBFC-131B3	一氟三溴乙烷
HBFC-132B2	二氟二溴乙烷
HBFC-133B1	三氟一溴乙烷
HBFC-141B2	一氟二溴乙烷
HBFC-142B1	二氟一溴乙烷
HBFC-151B1	一氟一溴乙烷
HBFC-21B2	一氟二溴甲烷
HBFC-221B6	一氟六溴丙烷
HBFC-222B5	二氟五溴丙烷
HBFC-223B4	三氟四溴丙烷
HBFC-224B3	四氟三溴丙烷
HBFC-225B2	五氟二溴丙烷
HBFC-226B1	六氟一溴丙烷
HBFC-22B1	二氟一溴甲烷
HBFC-231B5	一氟五溴丙烷
HBFC-232B4	二氟四溴丙烷
HBFC-233B3	三氟三溴丙烷

英文全名/化學式	中文名稱
HBFC-234B2	四氟二溴丙烷
HBFC-235B1	五氟一溴丙烷
HBFC-241B4	一氟四溴丙烷
HBFC-242B3	二氟三溴丙烷
HBFC-243B2	三氟二溴丙烷
HBFC-244B1	四氟一溴丙烷
HBFC-251B3	一氟三溴丙烷
HBFC-252B2	二氟二溴丙烷
HBFC-253B1	三氟一溴丙烷
HBFC-261B2	一氟二溴丙烷
HBFC-262B1	二氟一溴丙烷
HBFC-271B1	一氟一溴丙烷
HBFC-31B1	一氟一溴甲烷
HCFC-121	一氟四氯乙烷
HCFC-122	二氟三氯乙烷
HCFC-123	三氟二氯乙烷
HCFC-124	四氟一氯乙烷
HCFC-131	一氟三氯乙烷
HCFC-132	二氟二氯乙烷
HCFC-133	三氟一氯乙烷
HCFC-141b	一氟二氯乙烷
HCFC-142b	二氟一氯乙烷
HCFC-151	一氟一氯乙烷
HCFC-21	一氟二氯甲烷
HCFC-22	二氟一氯甲烷
HCFC-221	一氟六氯丙烷
HCFC-222	二氟五氯丙烷
HCFC-223	三氟四氯丙烷
HCFC-224	四氟三氯丙烷
HCFC-225	五氟二氯丙烷
HCFC-225ca	五氟二氯丙烷
HCFC-225cb	五氟二氯丙烷
HCFC-226	六氟一氯丙烷
HCFC-231	一氟五氯丙烷
HCFC-232	二氟四氯丙烷
HCFC-233	三氟三氯丙烷
HCFC-234	四氟二氯丙烷
HCFC-235	五氟一氯丙烷
HCFC-241	一氟四氯丙烷
HCFC-242	二氟三氯丙烷
HCFC-243	三氟二氯丙烷
HCFC-244	四氟一氯丙烷

英文全名/化學式	中文名稱
HCFC-251	一氟三氯丙烷
HCFC-252	二氟二氯丙烷
HCFC-253	三氟一氯丙烷
HCFC-261	一氟二氯丙烷
HCFC-262	二氟一氯丙烷
HCFC-271	一氟一氯丙烷
HCFC-31	一氟一氯甲烷
Heptabromodiphenyl ether	七溴二苯醚
Heptachlor	飛佈達
Hexabromobiphenyl	六溴聯苯
Hexabromodiphenyl ether	六溴二苯醚
Hexachlorobenzene (HCB)	六氯苯
α -Hexachlorocyclohexane	α -六氯環己烷
β -Hexachlorocyclohexane	β -六氯環己烷
Lindane	靈丹
Methyl bromide	溴化甲烷
Mirex	滅蟻樂
PCDDs/PCDFs	戴奧辛化合物
Pentabromodiphenyl ether	五溴二苯醚
Pentachlorobenzene	五氯苯
Perfluorooctane sulfonate	全氟辛烷磺酸鹽
Perfluorooctane sulfonic acid	全氟辛烷磺酸
Perfluorooctane sulfonyl fluoride	全氟辛基磺醯氟
Polychlorinated biphenyls (PCB)	多氯聯苯
Tetrabromodiphenyl ether	四溴二苯醚
Toxaphene	毒殺芬
1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)	三氯乙烷

附件 3-7 土地買賣契約書

立買賣契約人 出賣人：高雄市政府（以下簡稱甲方）
法定代理人：韓國瑜
代理機關：高雄市政府經濟發展局
法定代理人：伏和中
承買人：○○○○（以下簡稱乙方）
法定代理人：

本契約土地產權買賣事項，經甲乙雙方一致同意訂立條款如後，以資共同遵守：

第1條 買賣標的

高雄市大寮區○○段○小段○○○○地號等○筆土地（以下簡稱買賣標的），面積計○○○○平方公尺。

第2條 面積誤差

- 一、前條土地面積以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準，如有誤差應就超過或不足部份按土地原出(標)售價格相互找補土地價款。
- 二、乙方於辦妥產權移轉登記後，如因地政機關地籍圖重測或複丈致面積變更者，應按地政法規相關規定辦理。

第3條 應繳價款

- 一、土地價款：新台幣○○○○○○元整。
- 二、產業園區開發管理基金：新台幣○○○○元整，本項費用依本條第一項土地價款之1%計算，乙方應於土地所有權移轉登記前繳納本項費用至高雄市產業園區開發管理基金。

第4條 土地點交

- 一、乙方依繳款通知繳清土地價款及產業園區開發管理基金，由甲方以書面通知乙方至現場按現況點交土地，並確認買賣標的土地邊界及樁位點，乙方無故不到現場點交者，視同已點交。
- 二、買賣標的自點交之日起，其所受之利益及危險，均歸屬乙方負擔，不因土地產權未移轉而受影響，乙方對其承購之土地應負責維護管理，並須盡善良管理人之注意義務。
- 三、乙方於點交土地時應對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款或點交。

第5條 土地稅賦

乙方應自土地點交之日起依甲方通知期限按時繳交買賣標的相關土地稅賦，未滿一年者，按日依比例計算應繳交之稅賦。

第6條 完成使用認定標準及未依規定完成使用規定

乙方應依相關規定完成使用，其認定標準及未依規定完成使用，悉依產業創新條例第46-1條、產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法及和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售要點相關規定辦理。

第7條 維護費

乙方應依產業創新條例第53條規定繳交下列各項維護費用：

- 一、一般公共設施維護費。
- 二、污水處理系統使用費。
- 三、其他特定設施之使用費或維護費。

第8條 工作安全

乙方應於施工期間在工地設置安全設施，設置方式和地點應按勞工安全衛生法辦理。因工作安全或其設施所致之任何損害、糾紛概由乙方自行負責一切民、刑事及相關責任，與甲方無涉。

第9條 契約之修正

本契約之修正經雙方同意後，應以書面為之。

第10條 適用法律及紛爭解決

- 一、本契約之準據法為中華民國法律。
- 二、就本契約所生之爭議，而致發生訴訟時，雙方同意以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。

第11條 契約份數

本契約正本1式2份，由甲、乙雙方各執1份為憑；副本5份，甲方執4份，乙方執1份。

第12條 附則

本契約若有未盡事宜，悉依產業創新條例暨其施行細則及其子法、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法及其他相關法令規定辦理。

第13條 附件

本契約附件：

- 一、土地標示及面積清冊。
- 二、買賣標的位置圖。
- 三、買賣標的審查會議記錄。
- 四、○○公司承購和發產業園區土地投資營運計畫書。
- 五、和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售要點。

立契約人（甲方）：高雄市政府

法定代理人：韓○○

代理機關：高雄市政府經濟發展局

法定代理人：伏○○

地 址：高雄市苓雅區四維三路2號

立契約人（乙方）：

法定代理人：

地 址：

中 華 民 國 ○ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

肆、和發產業園區土地使用分區管制要點

為促進高雄市和發產業園區土地利用的合理性與效率性，並塑造園區環境風格，使整體規劃符合公共安全、環境衛生與發展寧適性等目標。據此，對本園區土地及建築物之使用，按「產業創新條例」、「都市計畫法」第 22 點及同法高雄市施行細則，訂定土地使用分區管制要點。

第一點 本要點依據都市計畫法第二十二點規定訂定之。

第二點 本園區內土地及建築之使用管制，依本要點規定辦理，本要點未規定者，依產業創新條例及其他相關法令辦理。

第三點 本園區內土地使用依產業創新條例劃設為下列用地：

一、產業專用區：

(一) 第一種產業專用區 (產業用地(一))。

(二) 第二種產業專用區 (產業用地(二))。

二、公共設施用地。

三、其他經中央主管機關核定之用地。

第四點 第一種產業專用區 (產業用地(一)) 係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：

一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：

(一) 金屬製品製造業 (25)；

(二) 電子零組件製造業 (26)；

(三) 電腦、電子產品及光學製品製造業 (27)：

但放射性工業 (包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業)，不得進駐本產業園區；

(四) 電力設備製造業 (28)，但不包含電池製造業 (282)；

(五) 機械設備製造業 (29)；

(六) 汽車及其零件製造業 (30)；

(七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31)；

(八) 其他經環境影響評估審查通過同意引進之產業類別。

二、電力及燃氣供應業。

三、批發業 (不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業)。

四、倉儲業 (含儲配運輸物流)。

五、資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。

六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

七、污染整治業。

八、洗衣業（具中央工廠性質）。

專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。

工業主管機關對於第一種產業專用區（產業用地(一)）之使用用途規定有變更時，得逕依工業主管機關之規定調整。

第五點 第一種產業專用區（產業用地(一)）得併供下列附屬設施使用：

一、辦公室。

二、倉庫。

三、生產實驗及訓練房舍。

四、環境保護設施。

五、單身員工宿舍。

六、員工餐廳。

七、從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

第六點 第二種產業專用區（產業用地(二)）係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

一、住宿及餐飲業。

二、金融及保險業。

三、機電、管道及其他建築設備安裝業。

四、汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。

五、電信業。

六、第四點第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。

七、其他教育服務業。

八、醫療保健服務業。

九、創作及藝術表演業。

十、其他經中央主管機關核准之行業。

第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該

建築物總樓地板面積百分之三十。

第七點 管理服務用地係供園區管理機構行政、金融、商務、會議、展示、研討、表演及娛樂、餐飲、防救災等多功能使用為主，其容許使用項目：

- 一、行政機關。
- 二、金融、保險分支機構。
- 三、產品展示陳列設施。
- 四、會議設施、集會堂。
- 五、職業訓練教育設施。
- 六、創業輔導設施。
- 七、安全、衛生、福利、醫療設施。
- 八、通訊設施與機構。
- 九、公用事業設施。
- 十、招待所、員工活動中心。
- 十一、轉運設施、停車場。
- 十二、餐飲業。
- 十三、警察消防機構。
- 十四、其他經中央主管機關核准之服務設施。

第八點 公共設施用地之容許使用項目如下：

- 一、公園兼滯洪池用地：供綠化景觀設施、水土保持設施、防洪設施、滯洪池、生態保育設施等使用；並得供輸配電鐵塔使用。
- 二、綠地：以綠化使用為主，並得為防風林、景觀綠帶、隔離綠帶、供輸配電鐵塔等設施使用。
- 三、溝渠用地：供灌溉、排水等設施使用。
- 四、自來水用地：供自來水事業設施及其附屬設施使用。
- 五、電力事業用地：提供電力事業及其附屬設施使用。
- 六、環保設施用地：提供污水處理、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施使用。
- 七、停車場用地：供興建平面、立體停車場、相關交通服務設施及其附屬設施使用。
- 八、道路用地：供道路及相關道路附屬設施使用。
- 九、溝渠(兼道路)用地：供排水設施使用，並兼供道路使用。
- 十、天然氣設施用地：供天然氣整壓配氣相關設施使用。

第九點 法定建蔽率及容積率上限規定如下：

使用分區/用地		建蔽率 (%)	容積率 (%)	
第一種產業專用區 (產業用地(一))		60	210	
第二種產業專用區 (產業用地(二))		60	300	
公共設施用地	管理服務用地	60	240	
	公園(兼滯洪池)用地	15	30	
	綠地	0	0	
	溝渠	0	0	
	自來水用地	50	150	
	電力事業用地	50	150	
	停車場用地	平面	10	20
		立體	80	240
	環保設施用地		50	150
天然氣設施用地		50	150	

為因應廠商進駐設廠之需求，提高土地使用彈性，第一種產業專用區容積管制規定如下：

- 一、第一種產業專用區容積率不得超過 210%，惟申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過 300%。
- 二、目的事業主管機關應進行本計畫範圍內第一種產業專用區總容積管制，即和春基地第一種產業專用區總容積不得超過 1,229,040 平方公尺；大發基地第一種產業專用區總容積不得超過 822,480 平方公尺。

第十點 本園區內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

- 一、停車場週邊(含退縮地)應設置寬度 2 公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及 1.5 公尺以上綠籬適當分隔停車空間。
- 二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。
- 三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。

第十二點 本園區內建築基地之附設停車空間應依下表規定辦理：

使用分區	汽車停車位	機車停車位
第一種產業專用區 (產業用地(一))	樓地板面積每 250 平方公尺設置一輛，經計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置一輛。停車空間得以機械停車方式為之。	樓地板面積每 300 平方公尺設置一輛。
第二種產業專用區 (產業用地(二))		
管理服務用地		

說明：1. 樓地板面積之計算，不包括室內停車空間、法定防空避難設備、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部份。所謂「類似用途」空間係指「為建築物之必要附屬設備空間或因廠房之特殊作業行為所衍生之空間，不因增設該空間而產生停車空間需求者為限」。

2. 建築物附設之停車空間數量中，應提供不少於百分之二停車數量為行動不便停車位（數量未達整數時，其零數應設置一輛）。

3. 其他均依建築技術規則之規定辦理。

建築基地之自行車停車位應依「高雄市都市設計審議地區建築基地附設自行車停車位規定」辦理。

第十三點 本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

使用分區	應附設裝卸位數
第一種產業專用區 (產業用地(一))	每一基地至少須附設一裝卸位。
第二種產業專用區 (產業用地(二))	樓地板面積在 500 平方公尺(含)以上至 3000 平方公尺(含)者，應附設一裝卸位，總樓地板面積 3000 平方公尺以上者，每超過 3000 平方公尺或其零數應增設一裝卸位。

說明：1. 每一裝卸位寬度不得小於 4 公尺、長度不得小於 13 公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2 公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。

2. 裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。

3. 貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。

4. 基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。

第十四點 本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

一、指定退縮地規定如下：

	建築基地面臨道路寬度				非臨道路側	
	30 公尺	20 公尺	15 公尺	5 公尺	臨省道 及市道	其他
退縮深度 (公尺)	8	6	5	4	5	3

二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如圖 5-5 所示。

三、自來水用地及電力事業用地臨綠地側，得免退縮。

四、大發基地環保設施用地應自地界周邊分別至少退縮 10 公尺建築，並應妥予植栽綠化作為區隔，不受上表列之退縮地建築規定；另和春基地環保設施用地淨寬僅 26 公尺，依上表之退縮建築規定辦理。

五、和春基地管理服務用地南側應自地界周邊至少退縮 6 公尺建築。

六、退縮地臨道路側應留設 1 公尺之植草緩衝帶，其餘種植高度低於 1.5 公尺之灌木，並等距列植喬木（如圖 5-6），植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。

七、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備（如電力、電信箱），應予遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。

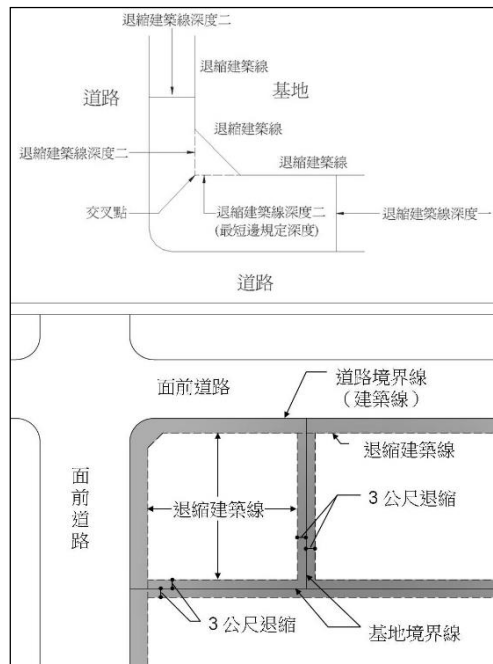


圖 5-5 建築基地退縮示意圖

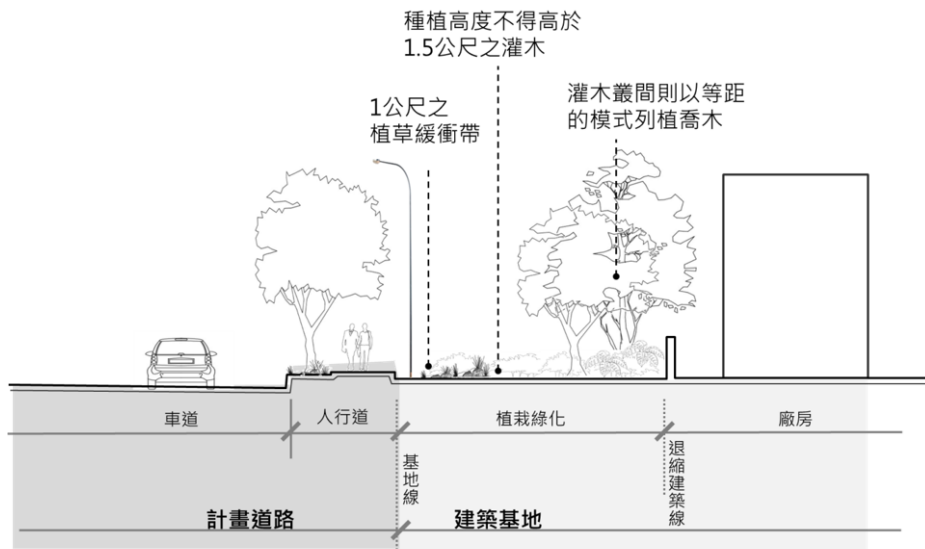


圖 5-6 臨計畫道路之建築基地退縮示意圖

- 第十五點 建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。有關綠覆率、綠覆面積之計算基準悉依「高雄市都市設計審議原則」辦理。
- 第十六點 面臨 30 米四號計畫道路及省道台 88 線（市道 188 線）之建築基地，該道路沿線不得設置車輛出入口。惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。
- 第十七點 本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。
- 第十八點 建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。
- 第十九點 屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

第二十點 本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條(綠建材)之規定辦理，且立面材料不得使用石綿瓦、塑膠浪板、未經處理之金屬浪板、其他具公害或易燃性材料。

第二十一點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

(一) 應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺。

(二) 標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

(三) 標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺。

二、建築物壁面標示物

(一) 僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

(二) 每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

(三) 牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點 各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。

第二十三點 前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於 250 公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十四點 植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十五點 沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二十六點 本園區各基地免依建築技術規則設置雨水貯集滯洪設施。

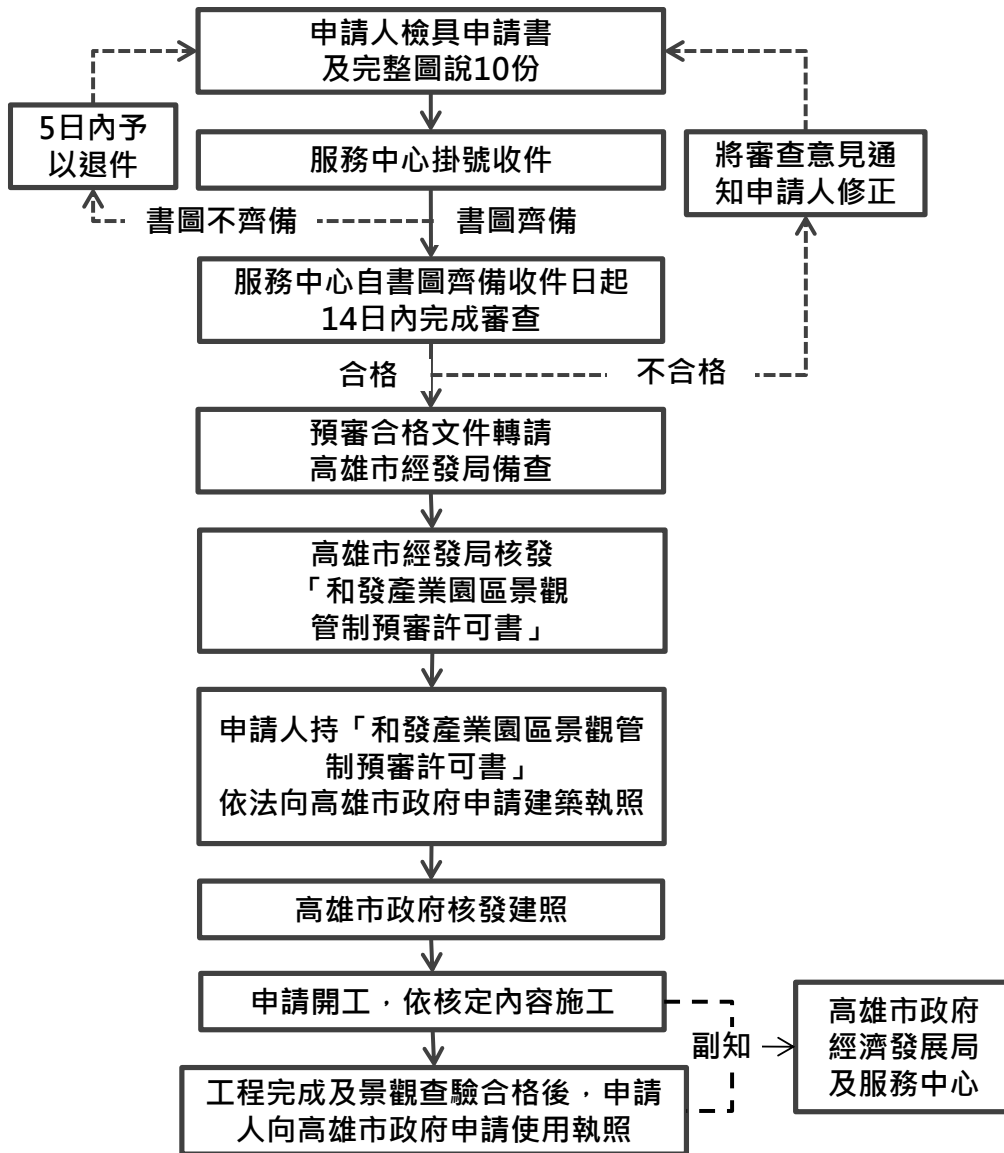
伍、和發產業園區建築景觀預審規範

壹、總則

- 一、為增進和發產業園區(以下簡稱本園區)土地合理有效利用，符合公共安全及促進都市環境(自然環境、人文環境、實質環境)與建築群體及人為活動間之和諧關係，特訂定和發產業園區建築景觀預審規範(以下簡稱本規範)。
- 二、本園區各建築基地之開放空間及景觀設計應依本規範之規定辦理，本規範未規定者，則應配合相關法令規定辦理。
- 三、本規範由和發產業園區服務中心(以下簡稱服務中心)負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。
- 四、本規範係配合變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫(和發產業園區)細部計畫(配合公用事業設施相關用地調整)案辦理。

貳、申請程序與審議流程

- 一、起造人申請建築相關執照前，應依本規範及建築相關法令，向服務中心申請預先審核，必要時得召開審查會議，並請起造人與設計人到場說明。
- 二、和發產業園區建築景觀預審作業程序



註：本規範由服務中心負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。

- 三、 申請人取得建造執照後，如需辦理變更設計，應依前點建築景觀預審作業程序辦理；但變更內容符合「高雄市都市設計審議許可案件變更設計作業要點」第5點及第6點者，由申請人逕向本府工務局申請，並應主動函知本府經濟發展局備查，以作為完工後景觀查驗之依據。
- 四、 申請人於工程完工後，應向本府申請景觀查驗，併同變更或破壞已完工之公共設施一併查驗，通過後始得申請使用執照。

參、建築景觀預審規範

第一部分：細部計畫土地使用分區管制要點

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

- 一、停車場週邊（含退縮地）應設置寬度 2 公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及 1.5 公尺以上綠籬適當分隔停車空間。
- 二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。
- 三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。

第十四點 本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

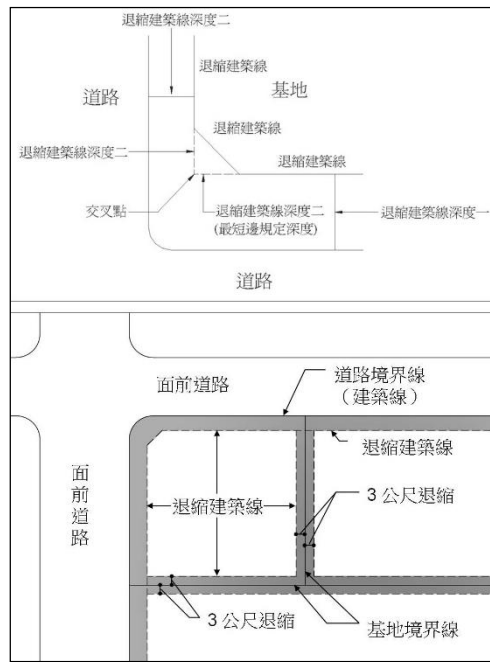
一、指定退縮地規定如下：

	建築基地面臨道路寬度				非臨道路側	
	30 公尺	20 公尺	15 公尺	5 公尺	臨省道及市道	其他
退縮深度（公尺）	8	6	5	4	5	3

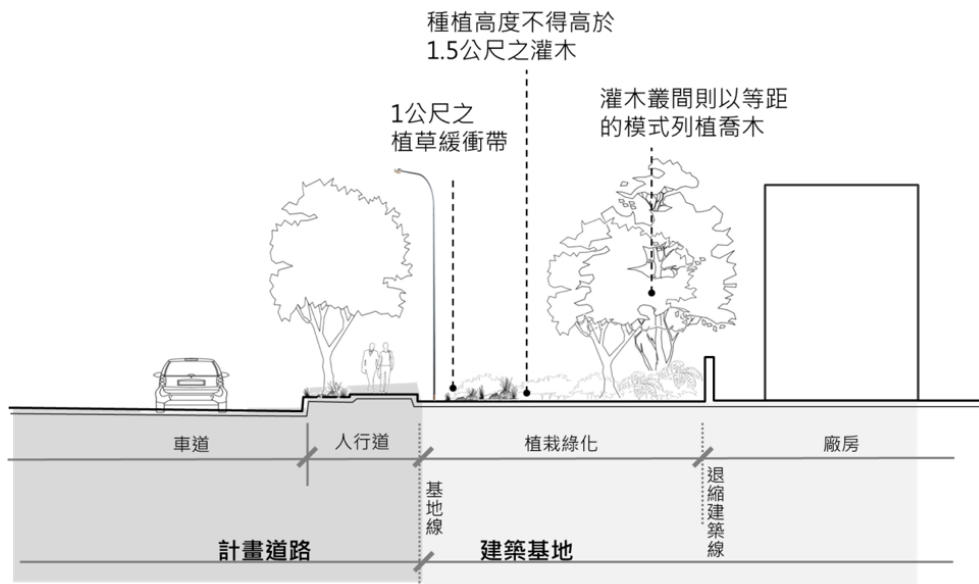
二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如下圖所示。

三、退縮地臨道路側應留設 1 公尺之植草緩衝帶，其餘種植高度低於 1.5 公尺之灌木，並等距列植喬木（如下圖），植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。

四、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備(如電力、電信箱)，應予遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。



建築基地退縮示意圖



臨計畫道路之建築基地退縮示意

第十五點 建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。有關綠覆率、綠覆面積之計算基準悉依「高雄市都市設計審議原則」辦理。

第十八點 建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。

第十九點 屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

第二十一點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

- (一)應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺。
- (二)標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- (三)標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺。

二、建築物壁面標示物

- (一)僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- (二)每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。
- (三)牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點 各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。

第二十三點 前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

- 一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於 250 公分。
- 二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

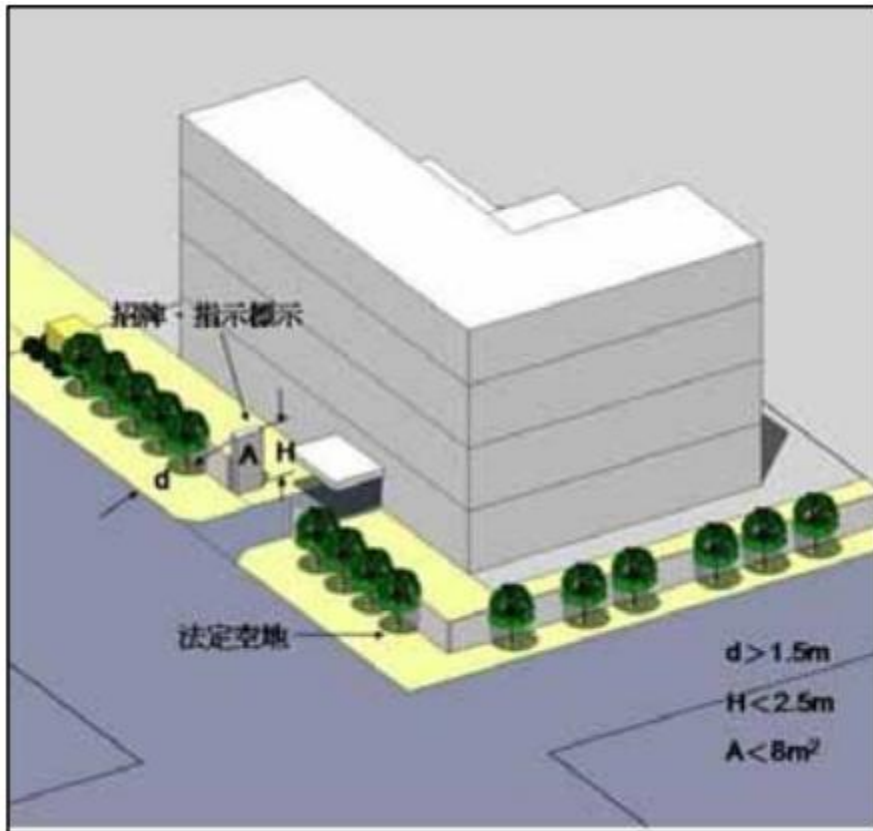
第二十四點 植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車

輛出入口。

第二十五點 沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二部分、其他規定事項

- 一、突出於地面層之通風口、台電變電箱宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化。
- 二、各基地內人行步道應設置步道燈照明、開放空間加強照明。
- 三、各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每五十平方公尺各至少栽種二棵計，少於十棵者以十棵計，餘數不滿五十平方公尺者以二棵計，喬木高度應至少二公尺。
- 四、各建築基地綠化植栽之選用，應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量百分之五十以上，並應自行負擔移植相關費用。移植喬木存活率未達 80% 以上者，應向本園區服務中心提出合理說明，說明理由未經本園區服務中心同意者，依該喬木徵收補償價格之 2 倍計收罰金。
- 五、建築基地內之栽種植種，除基地內既有留存移植之樹木外，不得種植外來種，應選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物。
- 六、本園區建築物主結構應以鋼筋混凝土或鋼架等耐火材料為主，建築物及基地出入口不得阻礙或破壞現有排水系統，且不得對道路交叉口截角開設，出入口寬度不得大於 36 公尺，自原道路人行道範圍內應一併設計、施工，且由使用者管理維護。
- 七、土地使用分區管制要點第 21 點所述基地出入口標示物示意如下圖。

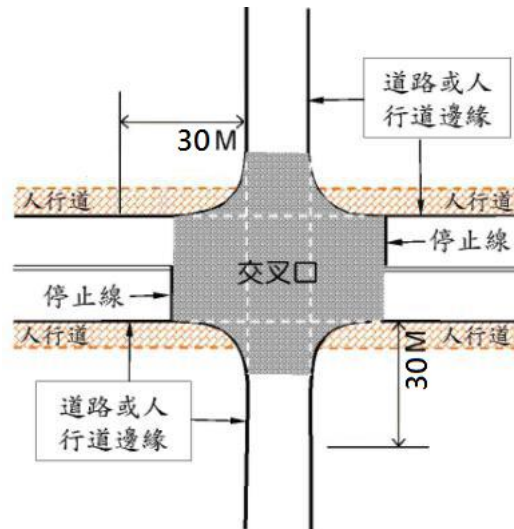


基地出入口標示物示意圖

第三部分、面臨 30 公尺四號計畫道路設置車輛出入口

面臨 30 公尺四號計畫道路之建築基地，該道路沿線原則不得設置車輛出入口，惟因基地開發需求，符合下列規定並經管理機構同意者，得申請設置車輛出入口。

- 一、 建築基地臨接 30 公尺計畫道路，位於計畫道路交叉口 30 公尺範圍內，不得設置汽機車出入口。



- 二、 建築基地同時臨接二條道路者，於 30 公尺計畫道路側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置貨車出入口。
- 三、 接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於 40 公尺。
- 四、 汽機車出入口應設置緩衝空間，自建築線後退二公尺之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各六十度以上範圍無礙視線之空間。
- 五、 建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果為準，應依審議決議及核備圖說辦理。

肆、建築景觀預審需檢附文件

一、本園區之建築景觀預審申請應具備景觀管制要點審查申請書(附件一)、建築景觀預審自行檢核表(附件二)、建築景觀預審計畫書圖應載明內容自行檢核表(附件三)、建築景觀預審計畫書圖，裝訂成 A3 格式，一式四份，送服務中心辦理審查作業。

二、建築景觀預審計畫書圖應載明事項：

- (一) 簡述建築內容、設計目標及構想。
- (二) 基地位置圖：載明基地位置、地號及道路名稱。圖面比例尺不得小於一千分之一。
- (三) 基地現況與周邊環境概述：配合圖文及照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於四百分之一，且至少包含鄰近基地界線三十公尺範圍。
- (四) 基地配置圖：載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於四百分之一。
- (五) 景觀配置圖：基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於四百分之一。
- (六) 基地其他設施圖：載明基地需設置水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於一百分之一。
- (七) 建築設計圖：載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於四百分之一。

附件一 和發產業園區建築景觀預審規範審查申請書

標號	(服務中心填寫)	
備案日期文號	年 月 日 字第	號 (服務中心填寫)
案名		
基地地址		
起造人	姓名(名稱)	(簽章)
	地址	
	身分證或營利事業統一編號	
	出生年月日	
	電話	
	傳真	
	電子郵件	
設計人	姓名(名稱)	(簽章)
	地址	
	營利事業統一編號	
	執開業證書字號	
	電話	
	傳真	
	電子郵件	

附件二 和發產業園區建築景觀預審規範自行檢核表

點次	檢討內容		檢討結果		說明頁碼	
			符合	未符合		
第一部分、細部計畫土地使用分區管制要點						
第十一點	本園區內停車場用地之規劃與設計原則	停車場週邊(含退縮地)應設置寬度 2 公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及 1.5 公尺以上綠籬適當分隔停車空間	檢討：			p. ~p.
		每處停車場之聯外出入口不得超過兩個	檢討：			p. ~p.
		每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽	檢討：			p. ~p.
第十四點	建築基地面臨道路寬度	<input type="checkbox"/> 面臨 30 公尺道路，退縮 8 公尺 <input type="checkbox"/> 面臨 20 公尺道路，退縮 6 公尺 <input type="checkbox"/> 面臨 15 公尺道路，退縮 5 公尺 <input type="checkbox"/> 面臨 5 公尺道路，退縮 4 公尺	面臨 30 公尺道路實設退縮 公尺；面臨 20 公尺道路實設退縮 公尺；面臨 15 公尺道路實設退縮 公尺；面臨 5 公尺道路實設退縮 公尺			p. ~p.
	非臨道路側	<input type="checkbox"/> 臨省道及市道，退縮 5 公尺 <input type="checkbox"/> 其它者，退縮 3 公尺	臨省道及市道實設退縮 公尺；其它者實設退縮 公尺			p. ~p.
	建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線	檢討：				p. ~p.
	退縮地臨道路側應留設 1 公尺之植草緩衝帶，其餘種植高度低於 1.5 公尺之灌木，並等距列植喬木，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地	檢討：				p. ~p.
	退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備(如電力、電信箱)，應予遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定	檢討：				p. ~p.
第十五點	建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。有關綠覆率、綠覆面積之計算基準悉依「高雄市都市設計審議原則」辦理	實設綠覆率 %				p. ~p.
第十八點	建築物臨街立面之附屬設備(冷氣機、水塔、廢氣排出口等)應配合建築物立面整體設計或遮蔽	檢討：				p. ~p.
第十九點	屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。	檢討：				p. ~p.
	基地出入口標示	應設置於廠址使用之道路	檢討：			p. ~p.

點次	檢討內容		檢討結果		說明頁碼
			符合	未符合	
第二十一點	物	側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺			
		標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。	檢討：		p. ~p.
		標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺	檢討：		p. ~p.
	建築物壁面標示物	僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌	檢討：		p. ~p.
		每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。	檢討：		p. ~p.
		牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺	檢討：		p. ~p.
第二十二點	各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆		檢討：		p. ~p.
第二十三點	前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定	沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於 250 公分	檢討：		p. ~p.
		供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率	檢討：		p. ~p.
第二十四點	植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口		檢討：		p. ~p.
第二十	沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調		檢討：		p. ~p.

點次	檢討內容	檢討結果		說明頁碼
		符合	未符合	
五點				
第二部分、其他規定事項				
一	突出於地面層之通風口、台電變電箱宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化	檢討：		p. ~p.
二	各基地內人行步道應設置步道燈照明、開放空間加強照明	檢討：		p. ~p.
三	各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每五十平方公尺各至少栽種二棵計，少於十棵者以十棵計，餘數不滿五十平方公尺者以二棵計，喬木高度應至少二公尺	法定喬木植數量： 棵 實際喬木植數量： 棵		p. ~p.
四	各建築基地綠化植栽應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量百分之五十以上。	總喬木植栽數目： 棵 採用園區現有植栽移植數目： 棵		p. ~p.
五	建築基地內之栽種植種，除基地內既有留存移植之樹木外，不得種植外來種，應選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物。	檢討：		p. ~p.
六	本園區建築物主結構應以鋼筋混凝土或鋼架等耐火材料為主，建築物及基地出入口不得阻礙或破壞現有排水系統，且不得對道路交叉口截角開設，出入口寬度不得大於 36 公尺，自原道路人行道範圍內應一併設計、施工，且由使用者管理維護。	檢討：		
第三部分、面臨 30 公尺四號計畫道路設置車輛出入口(申請於 30 米道路開口者始需填寫)				
一	建築基地臨接 30 公尺計畫道路，位於計畫道路交叉口 30 公尺範圍內，不得設置汽機車出入口	檢討：		p. ~p.
二	建築基地同時臨接二條道路者，於 30 公尺計畫道路側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置貨車出入口	檢討：		p. ~p.
三	接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於 40 公尺	檢討：		p. ~p.
四	汽機車出入口應設置緩衝空間，自建築線後退二公尺之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各六十度以上範圍無礙視線之空間	檢討：		p. ~p.
五	建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果為準，應依審議決議及核備圖說辦理	檢討：		p. ~p.

註：申請人應視申請案性質依表列檢討項目逐項檢討，併於「檢討內容」欄中簡要說明，無須檢討項目亦請敘明免檢討原因。

附件三 建築景觀預審計畫書應載明內容自行檢核表

檢討項目	建築景觀預審計畫書圖應載明內容	檢討結果		說明頁碼
		符合	未符合	
簡述	建築內容、設計目標及構想			p. ~p.
基地位置圖	載明基地位置、地號及道路名稱。圖面比例尺不得小於一千分之一			p. ~p.
基地現況與週邊環境概述	配合圖文及照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於四百分之一，且至少包含鄰近基地界線三十公尺範圍			p. ~p.
基地配置圖	載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於四百分之一。			p. ~p.
景觀配置圖	基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於四百分之一。			p. ~p.
基地其他設施圖	載明基地需設置水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於一百分之一。			
建築設計圖	載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於四百分之一			p. ~p.
30米道路開口 (申請於30米道路開口者始需檢附)	現況實測圖：載明鄰近道路狀況，圖面比例不得小於二百分之一，因園區開發初期尚未興闢道路，如無則免附道路現況實測圖			p. ~p.
	現況照片及索引圖			p. ~p.
	汽機車出入口平面圖、剖面示意圖：需清楚表達臨計畫道路交叉口位置及鄰地關係，並標註距離，圖面比例不得小於二百分之一			p. ~p.
	相關證明文件及會勘公文：如經交通影響評估審議通過，應檢附審議決議及核備圖說			p. ~p.

陸、和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則

壹、資源或污染物總量管制審查處理流程圖

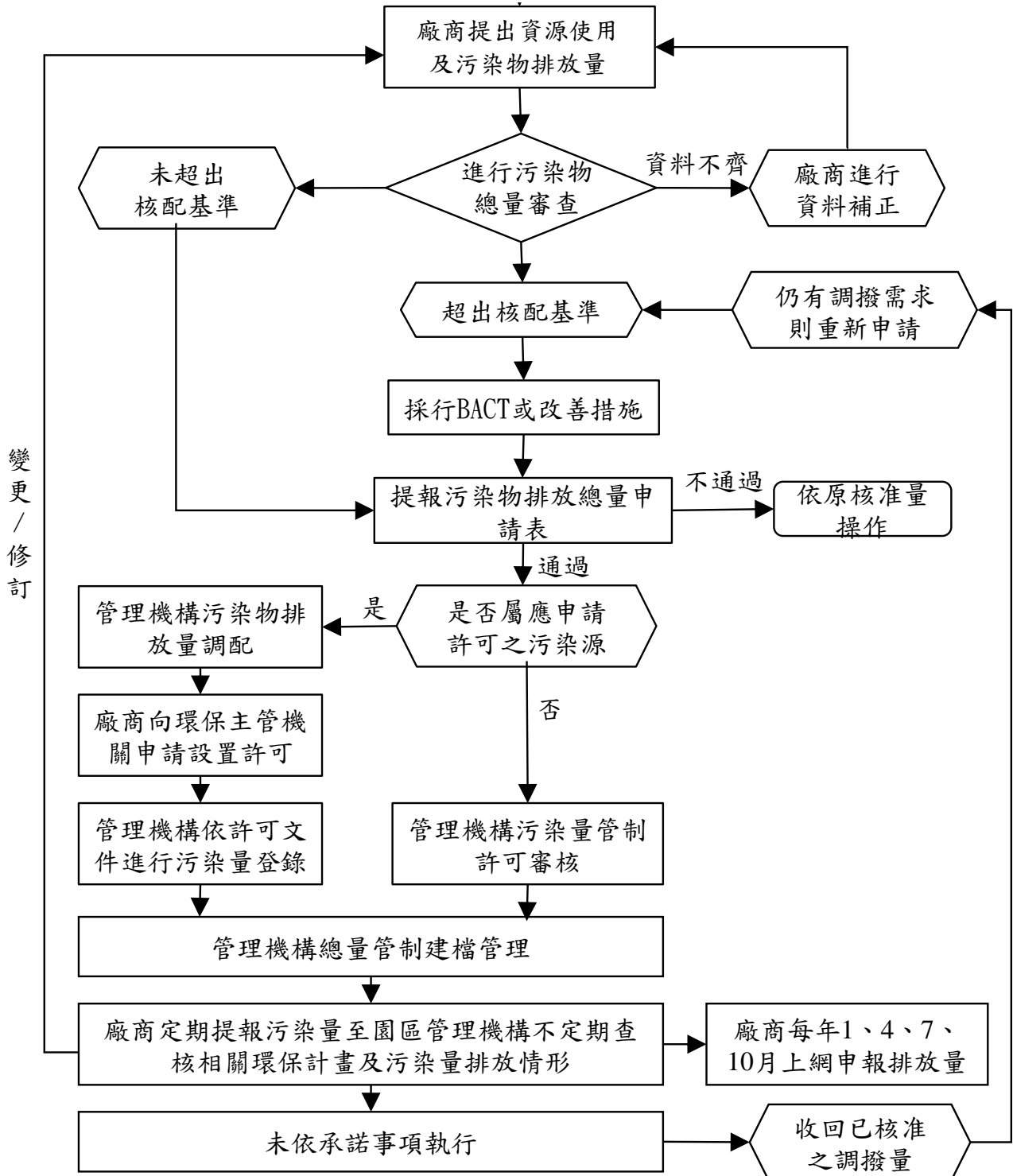


圖 1 和發產業園區資源或污染物總量管制審查流程圖

貳、資源或污染物總量管制審查核發原則

(一)和發產業園區(以下簡稱本園區)產業發展方向以低污染、低排放之產業為主導，並以購地核配量做為篩選廠商進駐之條件，針對污染物排放量採分配方式，廠商並無所有權。

(二)本園區廠商於申請入區時，應提出資源使用或污染排放量申請；變更資源使用及污染物排放量情形時，應提出變更；若園區總核配量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以購地面積比例等比例調整。廠商申請需檢具資源或污染物總量管制審查表(附件 1-1)及相關資料乙式 2 份，提送高雄市政府(以下簡稱本府)審查(廠商申請文件審查標準作業程序如附件 2)，資源或污染物總量管制審查處理流程如圖 1。

1. 入區申請：本園區廠商於用地租售審查階段及或有企業併購情形時，皆需依入區申請程序申請總量。於用地租售審查階段申請資源或污染量者，得以用地租售手冊中申購文件之申請表格申請。以企業併購方式申請者，其設廠用地原核准資源或污染量不得沿用，需重新申請，惟若「企業併購」情形係併入園區內既有廠商，則由該既有廠商以變更申請方式提出，該設廠用地原核准資源或污染量仍不得沿用。

2. 變更申請：本園區廠商因產業類別變更、製程改變、產能增加等情形，造成原核配量不足，或展延環保許可，得提出資源或污染量變更申請。

3. 總核配量變動：園區資源或污染總量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以購地面積等比例調整，不得有異議。

(三)資源或污染物總量管制精神為降低區域性環境污染，避免污染物過度集中，並藉由後續查核管理加強區內廠商對於污染物排放削減率與妥善管理污染排放量。

(四)調撥量申請及變更：

本園區廠商依「購地面積」核配資源或污染量，若核配量不足，或因產業類別變更、製程改變、產能增加等因素，造成原核配量不足嚴重影響營運或其他特殊因素考量，得向本府申請調撥資源或污染物排放

量，申請廠商應於調撥期間繳納環境回饋金，並簽訂調撥及減量切結書（附件 3、4），後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率。申請調撥應提送下列文件：

1. 廢氣排放量超過核配基準者應提出 BACT(最佳可行控制技術)，若該製程非屬環保署公告需採行 BACT(最佳可行控制技術)之製程，則應說明所採用控制技術較其他控制技術為佳之說明。
2. 廢(污)水質、量超過核配基準者，應提出廢(污)水管制計畫。
3. 廢棄物數量超過核配基準者，應提出廢棄物減量計畫。
4. 用電量或溫室氣體超過核配基準者，應提出用電減量計畫或溫室氣體抵減計畫(包括最佳可行技術 BAT 之採用方式與減量效益)，並需進行碳抵換，例如購買先期專案或抵換專案環保署審查核發之減量額度。

(五)調撥原則：

1. 各廠商於購地時已於購地申請書中提出各項資源或污染量申請，除配合本府整體政策經濟方針及重點產業引進，本府將不再進行園區資源或污染物總量提升之環評變更，廠商如有需申請調撥資源或污染物，各項資源或污染物調撥量以不得超出污染核配基準之 20% 為限，惟以專案向本府申請同意者，不在此限。惟園區總資源或污染量因環評變更有所變動時，各廠商之核配基準皆須依購地面積等比例調整，不得有異議。
2. 本園區廠商申請調撥資源使用或污染物排放量，為暫時性提供廠商維持正常營運，為達永續發展仍需請廠商採最佳可行性控制技術(BACT)或相關減量技術進行減量，本府後續將追蹤廠商進行查核管理作業，若廠商申請量大於實際排放量或未再繳環境回饋金，將收回調撥量。
3. 若近 2 年內遭陳情次數達 3 次以上之廠商（新租售廠商以舊廠認定，包含本府各局處之陳情次數），或認定有重大污染情形者不得申請污染物調撥量。
4. 有關環境回饋金執行經費計算公式及各項參數因子，為本府審核

時之內部參考依據，後續將配合環境現況及法規規定隨時進行修正。

5. 本府同意之核配量僅為暫時核配量，未來將以環保單位核發許可文件之許可量做為許可核配量，用電則以廠商申請用電契約容量作為許可核配量，並據以計算各項環境回饋金。

(六)本園區資源或污染物總量管制調撥審查將以下項目進行綜合評估，並由服務中心及本府指定之審查單位進行初審，再由本府進行複審同意。

1. 廠商污染特性
2. 污染物種類與風險
3. 污染物排放量合理性
4. 廠商是否已採行 BACT 或相關減量技術進行減量(若屬環保署公告之「固定污染源最佳可行控制技術」所列製程，可依公告採行相關控制技術並敘明)
5. 未來改善作為及減量措施
6. 後續廠內管理
7. 民眾陳情次數
8. 環境回饋金計算表

資源或污染物調撥量為暫時撥借，無法依撥借量作為是否調撥之依據，並非可無限期進行調撥，故仍需視整體綜合考量，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，故廠商應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。

(七)後續追蹤查核管理

1. 本園區廠商每年應於 1、4、7、10 月上網申報排放量，實際申報方式及頻率由服務中心另行通知。服務中心得依核准量查核事業單位之污染排放或使用情形，若有與前核准排放量不符者，可要求廠商應提出污染排放量變更申請資料辦理變更。如經查核年排放量仍超出核配量 10%或未達申請量 80%者，應提出說明，由服務中心研判後要求廠商配合增加污染防制設備以提升防制效率

- 或進行原核配污染物總量之檢討。
2. 服務中心依據環保局許可量進行查核，若廠商排放量有遠低於許可量之情形，得要求廠商向環保局申請修正許可文件並收回超出之調撥量。
 3. 若近 2 年內遭陳情次數達 3 次以上之廠商(包含本府各局處之陳情次數)，或認定有重大污染情形者，得收回超出之調撥量。
 4. 廠商變更或展延許可文件時，若檢核原核配量有高於許可量之情形，得重新檢討核配量以收回調撥量。
 5. 未來環保主管機關若有制定總量管制計畫，園區將配合進行排放量上限及管制措施之檢討改進，倘經主管機關認定需減量(包含 VOCs 減量/NOx 減量需求等)時，區內廠商應配合減量。

(八)「和發產業園區資源或污染物排放總量管理原則」管制內容未來有變更時，區內廠商應依申請污染物排放量時之最新規定辦理。

參、環境回饋金計算方式

因廠商向本園區申請資源或污染物總量調撥時，依上述說明須配合提出環境回饋金，計算方式說明如下：

(一)各項目單位費率

為使廠商能自主性檢討並降低其污染調撥量，擬訂環境回饋金單位費率如表 1，未來本府如有調整應依最新費率執行。

表 1 環境回饋金單位費率

污染物名稱	單位費率(每年)
總懸浮微粒	55,000 元/公噸
二氧化硫	11,000 元/公噸
二氧化氮	12,500 元/公噸
揮發性有機物	35,000 元/公噸
硝酸、硫酸及鹽酸	11,000 元/公噸
一般事業廢棄物	2,700 元/公噸
有害事業廢棄物	10,000 元/公噸
用水量或污水量[1]	與污水處理系統使用費費率一併擬訂
溫室氣體	340 元/公噸

(二)環境回饋金計算公式制定：

環境回饋金計算公式如下：

每年所需環境回饋金＝各項目單位費率×調撥量

在不超過環評總量之前提下，申請調撥量已自費購買抵換量部分，免予繳納回饋金，避免重複課予義務，然廠商應提出已自費購買抵換量之佐證資料。

(三)環境回饋金繳納方式

- 1.繳納方式：由服務中心依各項污染物調撥量計算後，發出繳費通知廠商，廠商以年繳方式辦理，調撥期滿如須續借需於到期一個月前提出申請並完成繳費作業，繳款至「高雄市產業園區開發管理基金」帳戶。
- 2.因整體綜合考量，由本府要求歸還或配合調整調撥量時，本府將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿一個月者以一個月計算)退還廠商。

附件 1-1

和發產業園區入區廠商資源或污染物總量管制審查表														
廠商名稱：									售地面積：					
污染物	總懸浮微粒 (公噸/年)	PM10 (公噸/年)	PM2.5 (公噸/年)	硫氧化物 (公噸/年)	氮氧化物 (公噸/年)	一氧化碳 (公噸/年)	揮發性有機化合物 (公噸/年)	其它酸氣 (公噸/年)	用水量 (公噸/日)	廢水量 (公噸/日)	一般事業廢棄物 (公噸/日)	有害事業廢棄物 (公噸/日)	用電量 (仟瓦)	溫室氣體 二氧化碳 (燃料) (公噸/年)
該公司購地核配基準														
設廠產生量														
是否超出核配基準														
調撥量														
同意核配量														
有關廢水部分需另依和發產業園區污水下水道排入限值及相關規定，申請納管取得許可後接管排放。														
審查結果：												(本欄由審查機關填寫)		

附件 2-1

名稱	園區總量管制及污染減量廠商申請文件審查標準作業程序
一、定義： 指入區、併購廠商及已核准進駐廠商以函文方式，進行資源或污染物總量管制之申請、變更等相關作業。	
二、適用對象： 入區、併購廠商及已核准進駐廠商。	
三、法規依據： 空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法、環境影響評估法及其他相關規定等。	
四、作業內容 <p>(一) 園區廠商以函文方式，檢附相關申請資料乙式 2 份，提出資源或污染物總量管制之申請或變更。</p> <p>(二) 相關資料由服務中心負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。</p> <p>(三) 由服務中心或負責審查單位進行文件審查作業，審查期限及作業流程如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 由廠商提出申請文件後，需於 5 工作日內完成初審作業並將審查意見知會廠商。2. 於初審階段，如有資料缺漏、內容誤植或不符合相關規定等情形，則要求廠商進行資料補正。3. 俟廠商以書面、傳真、E-mail 等方式進行資料補正後，需於 3 工作日內完成複審作業。4. 各階段之審查作業皆需填寫「工業區申請文件審查意見表」(如表 2.2-1)，並由審查人員簽名或蓋章(需加註審查日期)後，交由服務中心複審。5. 廠商申請文件總補正日數為一個月(補正次數以 3 次為限)，如逾期未完成者(或補正次數超過 3 次)，服務中心得以函文方式駁回申請文件。6. 各階段審查或補正作業之日數計算，皆不含起始日。	

(四) 資源或污染物總量管制審查作業要點：

1. 依廠商提出之設廠基本資料，判定資源或污染物申請項目及數量之合理性。
2. 如為資源或污染物總量變更，需要求廠商提供各項資源或污染物總量之計算方式，並檢視其正確性。
3. 資源或污染物總量核配以不得超過本府規定之「核配基準」為原則，核配基準參見附件 2-2。
4. 如廠商申請之資源或污染物總量有超出本園區「核配基準」之情形，則先評估其申請文件之合理性，及統計目前園區可用之調撥量及餘裕量，並將相關資料彙整後，另行簽辦。
5. 於審查完成後，立即更新園區廠商資源或污染物核配量總表。

(五) 於審查完成後，由服務中心以函文方式回覆廠商審查結果，並檢還申請書一份。

附件 2-2

項目	單位	核配基準
用水量	CMD/公頃	16
污水量	CMD/公頃	12.8
用電量	KW/公頃	681
溫室氣體	公噸/年/公頃	5257
一般事業廢棄物	公噸/日/公頃	0.3096
有害事業廢棄物	公噸/日/公頃	0
空氣污染物	公噸/年/公頃	0

註一：空氣污染物除溫室氣體外，尚包含 PM2.5、PM10、TSP、Sox、NOx、CO、VOCs、硫酸、硝酸、鹽酸等，並依本園區最新核定之環境影響評估報告管制。

註二：申請量超過核配基準者應依本園區資源或污染物排放總量管理原則之規定辦理，並填寫相關計畫申請調撥，經核准後始得進駐。

註三：因事業廢棄物入區申請量為每年產生量，本園區係以每年 240 工作日計算每日產生量作為管制依據。

註四：申請人申請混合使用產業用地(一)所列行業時，核配基準由本府依本園區產業用地(一)出(標)售手冊之規定審查後核配，惟其他經本府經發局核定之低污染製造業不得申請調撥。

產業類別	用水量 (CMD/公頃) (回收率)	污水量 (CMD/ 公頃)	用電量 (KW/ 公頃)	空氣污染物(公噸/年/公頃)								其他 氣體
				PM2.5	PM10	TSP	SOx	NOx	CO	VOCs	溫室 氣體	
08 食品及飼料製造業	59.8 (60%)	47.8	908	0.1030	0.1609	0.2575	0.3754	0.3059	0.1764	0.0071	6110	
22 塑膠製品製造業	7.5 (60%)	6.0	681	0.0139	0.0218	0.0349	0.3789	0.1290	1.1472	0.2099	5257	硫酸為 1.0853
231 玻璃及其製品製造業	8.2 (30%)	6.6	1,022	0.1154	0.1803	0.2884	0	0.0101	0	0.0732	6536	
25 金屬製品製造業	26.2 (45%)	20.9	624	0.3036	0.4744	0.7590	0.3012	0.9118	0.4900	0.1249	5044	硝酸為 0.0308
26 電子零組件製造業	373.7 (82%)	299.0	1,362	0.0508	0.0794	0.1270	0.3173	0.9986	0.4756	1.0733	7815	鹽酸為 0.5090
27 電腦、電子產品及光學製品製造業	8.2 (30%)	6.6	1,022	0.1154	0.1803	0.2884	0	0.0101	0	0.0732	6536	
28 電力設備製造業	20.9 (60%)	16.7	568	0.0012	0.0019	0.0031	0.0009	0.0040	0.0086	0.0239	4831	(僅電 子零組 件製造 業得申 請)
29 機械設備製造業	7.5 (54%)	6.0	568	0.0651	0.1017	0.1627	0.0266	0.0164	0.0072	1.2729	4831	
30 汽車及其零件製造業	19.4 (60%)	15.5	568	0.0651	0.1017	0.1627	0.0266	0.0164	0.0072	1.2729	4831	
31 其他運輸工具及其零件製造業	10.5 (60%)	8.4	568	0.0038	0.0060	0.0096	0.0763	0.0583	0.0216	1.6160	4831	
32 家具製造業	7.5 (60%)	6.0	568	0.0038	0.0060	0.0096	0.0763	0.0583	0.0216	1.6160	4831	
33 其他製造業	7.5 (60%)	6.0	568	0.0038	0.0060	0.0096	0.0763	0.0583	0.0216	0.0071	4393	
其他經本府經發局核定之低污染製造業												

註一：一般事業廢棄物單位面積核配基準為0.3096公噸/日公頃，有害事業廢棄物單位面積核配基準為0.0371公噸/日公頃。
 註二：園區用電量、溫室氣體(燃料)排放量高於平均值者需減量或提出溫室氣體減量計畫。
 註三：申請量超過核配(應填寫相關計畫(參見「拾壹、和發產業園區產業用地(一)土地申購書件」四、投資營運計畫書-污染防治說明書之說明)並經申請者應填寫同進駐，超過標準甚鉅者，本府經發局得不准其申購。
 註四：因事業廢棄物入區申請量為每年240工作日計算每日產生量作為管制依據。
 註五：其他經本府經發局核定之低污染製造業不得申請調撥。

附件 2-3

表 2.2-1 和發產業園區申請文件審查意見表

廠商名稱			
審查項目			
聯絡人		聯絡電話	

審查意見	

協審單位：_____

審查人員：_____

附件 3

和發產業園區資源或污染量調撥切結書

本公司_____，在不超過和發產業園區資源使用或污染物排放總量前提下，向高雄市政府經濟發展局申請調撥資源或污染物核配量(總懸浮微粒：_____公噸/年、硫氧化物：_____公噸/年、氮氧化物：_____公噸/年、一氧化碳：_____公噸/年、揮發性有機物_____公噸/年、有害事業廢棄物：_____公噸/日、一般事業廢棄物：_____噸/日、用電量：_____仟瓦、溫室氣體(燃料)：_____公噸 CO₂/年)，並承諾基於使用者付費原則，於調撥期間願繳納環境回饋金，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，另繳納之環境回饋金將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿一個月者以一個月計算)。

此致

高雄市政府經濟發展局

公司:_____

代表人:_____

中華民國_____年_____月_____日

附件 4

和發產業園區資源或污染物總量管制排放減量切結書

本公司 在法律處分之約束下，保證本公司取得資源或污染物調撥量後，於調撥核配量期間發生下列各項情事之一者，同意增加資源使用減量或污染防制設備以提升防制效率，或配合高雄市政府經濟發展局進行原核配資源或污染物總量之檢討：

1. 經查核資源或污染物之年平均使用或排放量若仍然超出許可核配量 10 % 以上或未達許可核配量 80% 者。
2. 經查核未繳納環境回饋金者。
3. 園區資源或污染總量因環評變更有所變動時，同意核配量依購地面積等比例調整。

特此切結，此致
高雄市政府經濟發展局

立切結書人：
身份證字號：
事業名稱：
地址：
電話：

中華民國 年 月 日

第三部分 出(標)售土地面積及出(標)售價格

捌、和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格



大發基地產業用地(二)土地出(標)售坵塊圖



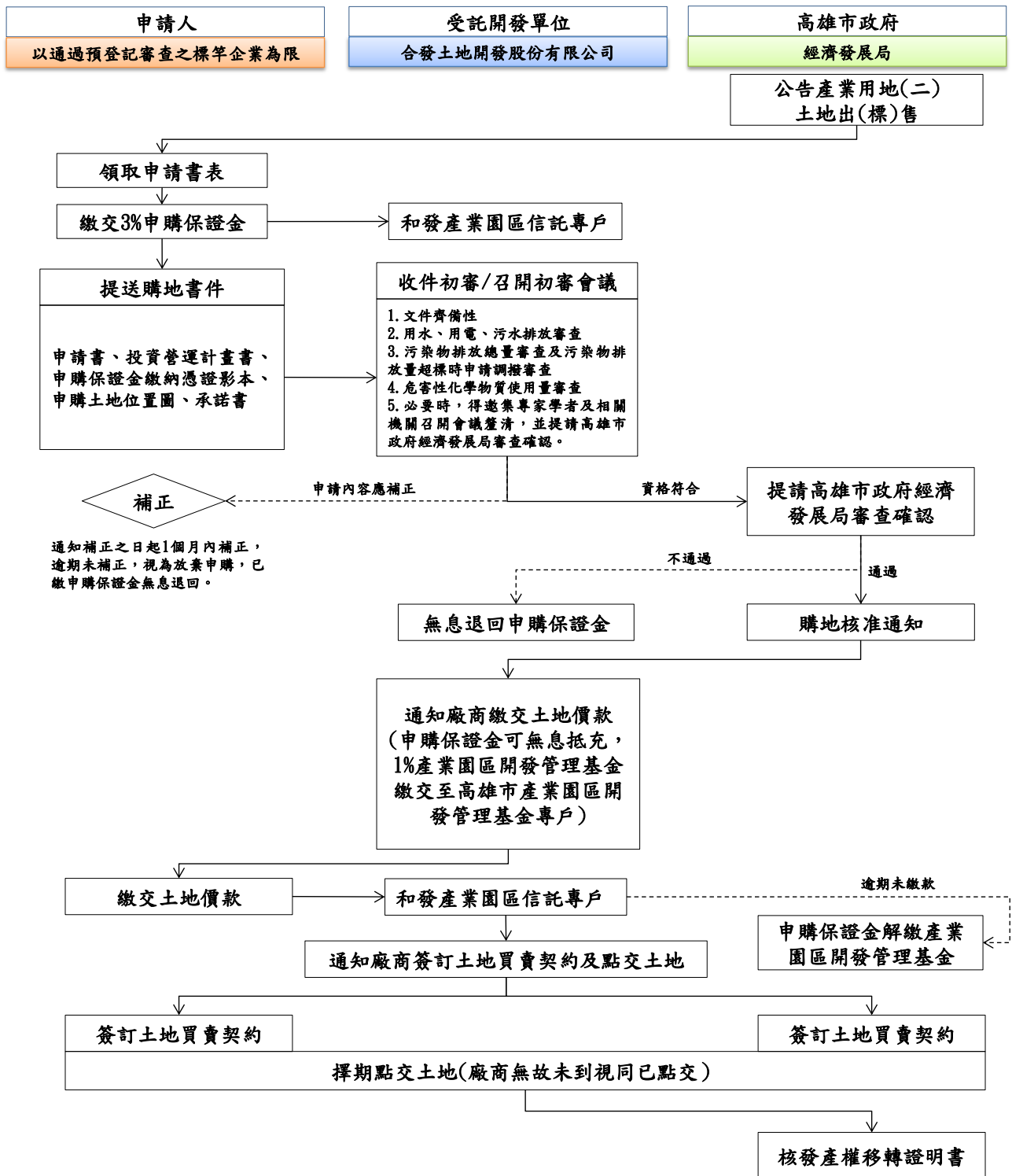
和春基地產業用地(二)土地出(標)售坵塊圖

和發產業園區產業用地(二)土地坵塊面積及出(標)售價格

坵塊 編號	面積 (m ²)	土地單價 (元/m ²)	土地總價 (元)	3%保證金 (元)
B1-1	5,230	38,236	199,974,280	5,999,228
B1-2	3,529	37,868	133,636,172	4,009,085
B1-3	3,378	39,781	134,380,218	4,031,407
B2	4,805	39,781	191,147,705	5,734,431
D1-1	4,555	38,629	175,955,095	5,278,653
D1-2	4,700	38,251	179,779,700	5,393,391
D1-3	4,709	38,251	180,123,959	5,403,719
D1-4	4,711	38,629	181,981,219	5,459,437
D1-5	4,738	37,872	179,437,536	5,383,126
D1-6	4,740	37,872	179,513,280	5,385,398
D1-7	4,737	38,251	181,194,987	5,435,850
D2-1	5,622	38,251	215,047,122	6,451,414
D2-2	5,620	37,872	212,840,640	6,385,219
D3	9,507	38,243	363,576,201	10,907,286

第四部分 申購流程及應備書件

玖、和發產業園區產業用地(二)土地出(標)售作業流程



拾、指定繳款行庫帳戶一覽表

款項類別	帳戶名稱	帳戶帳號
土地價款、申購保證金	中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	中國信託商業銀行營業部 901540509212
產業園區開發管理基金	高雄市政府經濟發展局產業園區開發管理基金	高雄銀行公庫部 102103032960

註：未來如本府與合發公司之契約屆期，將由本府經濟發展局統籌辦理各項業務，並另行通知辦理方式。

拾壹、和發產業園區產業用地(二)土地申購書件

茲擬申購高雄市和發產業園區之產業用地(二)，檢附有關申請書件 1 式 10 份，請 惠予審查。

此致 高雄市政府經濟發展局

本申購書件包含下列文件：

- 一、申請書
- 二、投資營運計畫書
- 三、繳納土地價款 3% 計算之申購保證金憑證影本，請向指定行庫帳戶繳納取據(未附申購保證金繳納憑證影本或金額不足或不符合規定繳交方式等，屬無法補正事項，視為資格不符，並不受理其申請)。
- 四、申購土地位置圖
- 五、承諾書(請蓋騎縫章)
- 六、混合使用產業用地(一)容許引進產業類別計畫書(如無則免)

註：營運投資計畫書之內容，於日後雙方簽定土地買賣契約時，視為該契約之一部分。